

仕様書案説明書

下記のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

記

1. 調達内容

- (1) 購入物品及び数量 テンダーX線ビームライン用フロントエンド機器の整備 一式

2. 意見の提出方法

- (1) 意見の提出期限 令和8年6月24日 17:00 (郵送の場合は必着のこと。)
(2) 提出先 〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
財務部契約課 川畑 夏姫
電話 043-206-3015 FAX043-251-7979
E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp
(3) 提出部数 1部

3. 仕様書案の説明会

- (1) 日時 令和8年6月15日 14:00
(2) 場所 〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻青葉 468-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
NanoTerasu センター 会議室 2
なお、参加を希望する場合は、必ず添付の参加申込書を提出すること。

4. 入札公告予定時期 令和8年7月下旬

5. その他

- (1) 意見の提出、照会は、添付の様式にて提出すること。
(2) 提出のあった意見に対して、当方より質問する場合がありますので意見提出の場合は、連絡窓口（住所、所属、氏名、電話番号、メールアドレス）を明記すること。

6. 添付書類

- (1) 仕様書案説明会参加申込書
(2) 意見提出用紙
(3) 仕様書（案）

以上

「テンダーX線ビームライン用フロントエンド機器の整備」
仕様書案説明会参加申込書

連絡担当窓口	企業等名称	
	(ふりがな) 氏名	
	所属部署名	
	所在地	
	電話番号	
	FAX番号	
	E-mail	
参加者氏名等	参加人数	(名)
	参加者氏名 ①	
	参加者氏名 ②	
	参加者氏名 ③	

※仕様書案説明会の参加者は、事前に参加登録された者のみとします。したがって、参加を希望する場合は、必ず本申込書を提出期限までに下記契約担当までご提出ください。

提出期限: 令和8年6月11日(木) 12:00(必着)

提出方法: Eメール添付により提出すること。

(提出先)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

財務部契約課 川畑 夏姫

E-mail: nyuusatsu_qst@qst.go.jp

FAX: 043-251-3015

TEL: 043-206-6262

仕様書案に対する意見

件名	テnder-X線ビームライン用フロントエンド機器の整備
----	-----------------------------

法人名 :	
所属部署 :	
氏名 :	
電話番号 :	
E-mail :	

No.	意見の内容
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

テンドーX線ビームライン用フロントエンド機器の整備
仕様書案

Manufacturing of a frontend for tender x-ray beamline

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

NanoTerasu センター

高輝度放射光研究開発部

加速器グループ

I, 一般仕様

1. 件名

テンダーX線ビームライン用フロントエンド機器の整備

2. 目的

本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下、「QST」という。）が、3GeV 高輝度放射光施設ナノテラス（以下、「ナノテラス」という。）の蓄積リングに設置する真空封止アンジュレータから出射される放射光を、テンダーX線ビームラインに導くための、フロントエンド機器（図 A 参照）の設計、製作及び、据付・調整等を行うものである。

3. 仕様範囲

テンダーX線ビームライン用フロントエンド機器の整備

1 式

- ① 必要な材料手配、製作、試験、梱包、輸送、搬入、据付け、アライメント、超高真空立上げ、遮蔽機器取り付け及びユーティリティ敷設、制御系機器敷設等一切を行うこと。
- ② 据付調整作業に必要な一切の測量機器（トランシット、鉛直器、オートレベラ、水準器、治具等並びに、ベーキングを含む真空作業及びユーティリティ敷設作業に必要な一切の部品、工具及び、消耗品（固着防止用のモリブデン、アルコール等）など、本案件を遂行するために必要な全ての物品は、受注者側で準備すること。
- ③ 納入時に使用した梱包材、現地での搬入及び作業時に養生などに使用した資材の廃棄は、受注者が行うこと。

4. 納入期限

令和 11 年 3 月 23 日（金）

ナノテラスでは放射光施設としての利用が開始されていることから、蓄積リング収納部内での機器の据付などが可能な期間は加速器停止期間に限られる。蓄積リングトンネル内での施作業は延べ 1 ケ月程度で据え付けられる工程とすること。なお、事前の準備、コンポーネント等の搬入及び設置準備等

については、この限りではない。搬入経路は図 B を参照のこと。詳細なスケジュールは、契約後に打合せのうえ決定する。物品製造後、納入までの保管は、受注者が行うこと。

5. 納入場所

宮城県仙台市青葉区荒巻青葉 468-1 ナノテラス内の指定する場所

6. 納入条件

据付調整後渡し。ナノテラス内の指定納入場所へ搬入、据付の後、真空立上げ作業、最終アライメントを実施した後、引き渡しを行うこと。試験検査成績書を納入すること。

7. 試験条件

試験前に試験検査要領書を提出し QST 担当者の確認を得ること。試験検査要領書に基づき試験を実施し、試験検査成績書を作成・提出すること。試験には必要に応じて QST 担当者が立会いをする。

①工場試験

物品製造段階にて技術仕様の各項目に記載した項目について試験を行うこと。

②)現地試験

据付・真空立上げ時に技術仕様の各項目に記載した項目について試験を行うこと。

8. 保管条件

物品製作後、納入までの保管は室温 5℃～40℃の室内で行うこと。またナノテラス搬入時を含め結露・錆が生じないように、梱包など適切な処置を行うこと。なお、ナノテラスの室温は 25℃程度である。

9. 契約不適合責任

契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。

10. 提出図書

提出図書のリストを下表に示す。

表：提出図書リスト

	図書名	提出時期	電子ファイル提出	部数
①	製作工程表	契約後速やかに	WORD (EXCEL) PDF	3 部

用のファイルを提出すること。

(提出場所)

宮城県仙台市青葉区荒巻青葉 468-1

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

NanoTerasu センター 高輝度放射光研究開発部 加速器グループ

11. 支給品

支給する物品のリストを下表に示す。

表：支給品リスト

	品名	数量	支給時期
①	FEPLC 制御盤	1 台	設置前
②	EtherCAT マスターカード搭載ラックマウントサーバ	1 台	設置前

支給場所： ナノテラス内の指定する場所

12. 貸与品

貸与する物品のリストを下表に示す。

表：貸与品リスト

	品名	数量	備考
①	窒素ガスボンベ	1 式	使用したガスは支給とする
②	ヘリウムガスボンベ	1 式	使用したガスは支給とする
③	移動式排気ポンプユニット	2 台	
④	ヘリウムリークディテクタ	1 台	
⑤	ベーキング用ヒーターコントローラ	1 式	
⑥	建屋内クレーン	1 式	
⑦	NEG ポンプ用制御装置	1 式	
⑧	水用電気伝導率計	1 式	
⑨	ベーク用リボンヒータ、熱電対、温度ロガー	1 式	
⑩	レーザートラッカー	1 式	

13. 品質管理

本件調達に係る設計・製作・据付け等は、管理体制、設計管理、外注管理、現地作業管理、材料管理、工程管理、試験・検査管理、不適合管理、記録の保管、重要度分類、監査、全ての工程にお

いて、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。

※全て網羅しなくとも可とする。受注者から品質保証計画書を提出により確認することでも可とする。

14. 適用法規・規格基準

本品の設計・製作・据付・試験検査にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。

- ① 労働安全衛生法
- ② 日本工業規格（JIS）
- ③ その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・期間・基準等

15. 知的財産権等

知的財産権については、知的財産権特約条項のとおりとする。

16. 機密保持

受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。このため、機密保持を確実にできる具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。

17. 安全管理

① 一般安全管理

- ・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
- ・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
- ・受注者は、作業着手に先立ち QST と安全について十分に打合せを行った後着手すること。
- ・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。
- ・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
- ・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。
- ・ナノテラスにおける設置作業にあたっては、ナノテラス作業ルール及び手引きに従うこと。

② 放射線管理

- ・本仕様の一部には放射線管理区域内での作業が含まれる。当該作業にあたっては、放射線作業従事者登録が必要であることを留意すること。
- ・放射線管理及び異常時の対策は、QST の指示に従うこと。

18. グリーン購入法の推進

- ・本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。
- ・本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

19. 協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST と協議のうえ、その決定に従うものとする。機器構成を含む詳細については、QST 担当者の指示に従うこと。

20. その他

- ① 物品識別タグ：本契約において納入する全物品のリストを、QST が指定する様式にて納入前に QST に提出すること。提出リストを元に、QST 側でユニーク識別コードが書かれたタグを準備し支給する。QST が指定した全物品に対し、支給タグを貼り付けた後に納入すること。タグを貼る箇所については別途指示する。
- ② 権利の帰属：本仕様書によって製作されたハードウェア等の図面を含む著作物の著作権は、QST に帰属するものとする。資料等から波及する特許の行使権は、QST に帰属する。
- ③ 技術打合せ：工程、詳細設計及び試験等に関する技術打合せを、必要に応じて QST 担当者の指示する日時・場所にて行い、受注者は 1 名以上の設計担当者（技術者）が出席すること。搬入、据付、真空立上げ、ユーティリティ敷設時には現場での工程管理を行い、他の作業などとの調整も行うこと。議事内容や決定事項を議事録として毎回提出すること。打合せ時の使用言語及び技術資料、議事録の使用言語は日本語とする。なお、第 1 回打ち合わせ（キックオフミーティング）は受注後 1 ヶ月以内に行うこと。必要に応じて web 会議システムなどの利用を認める。
- ④ 故障や不良等が発生した場合には速やかな対処が可能であること。また原因と対処方法を速やかに QST 担当者に報告すること。

II. 技術仕様

本件は、ナノテラス蓄積リングの長直線部に設置される真空封止アンジュレータを光源とするテnder-X線ビームラインのフロントエンド機器を製作する。フロントエンドはビームラインの先端部に位置し、光源で生成される放射光を安全かつ安定的に光学・輸送系に導くための超高真空装置である。

この装置の目的は、

- ① 放射光利用の際に起こりうる真空事故への対応を含め蓄積リングの超高真空状態を保護すること。
- ② 必要に応じて高出力放射光をマスク、アブソーバ及び、スリット等によって制御すること。
- ③ ビームシャッター等により放射線を遮蔽することによって安全な放射光利用を確保すること。この装置は基本的にリングトンネルに設置され、上流側の蓄積リングとは、光取出管端部に設置される手動式オールメタルゲートバルブ（仕様範囲外）で取り合う。

1. 構成

フロントエンドは、以下により構成される。ライン図(図:A)に構成模式図、ライン表(表:A)に配置参考値を示す。各装置の詳細は「III. 詳細仕様書」を参照すること。

- ① 放射光ビームを制御しつつ超高真空を達成するための真空装置部。(表 1)
- ② 各種真空装置を精度良く配置するためのビーム架台部。(表 2)
- ③ 各種真空装置を冷却するための冷却水配管部。
- ④ 真空装置の一種であるゲートバルブやビームシャッターを動作させるための圧空配管部。

以上各部の機器の動作を制御する制御盤部。なお、フロントエンド構成機器の全ての駆動信号、リミット信号、ドライブ信号などは、安定的な運転のために、加速器インターロックシステムで統合的に制御・監視される。各装置の詳細は「III. 詳細仕様書」を参照すること。

表 1: 真空装置部構成機器

機器名	数量	概要	III. 詳細仕様書
超高真空排気ユニット	1 式	ゲートバルブで区切られる各真空セクションに配置され超高真空を得るための装置。3種類の排気真空槽 (VPC1, VPC2, VPC3) と端部排気真空槽 (EVPC) からなる。	第 1.1 項
フォトンダクトアブソーバ	1 台	ビームライン閉鎖時に銅ブロックを光軸上にく下ろし、最上流ゲートバルブへの偏向電磁石からの漏洩光照射を防ぐ装置。	第 1.2 項
前置マスク HX 型	1 式	フロントエンド最上流部に設置され、水冷銅ブ	第 1.3 項

		ロックにより不要な放射光を吸収する装置。	
高速ビームシャッター (FCS)	1 式	真空漏れ事故時高速でシャッターを下ろし、蓄積リング真空系へのガスの流入を阻止する装置。	第 1.4 項
光軸調整用フィルタ (ADJFIL)	1 式	フィルタを挿入することにより放射光の低エネルギー成分を除去する装置。発生した熱は水冷により取り去る。	第 1.5 項
スクリーンモニタ (SCM)	2 台	蛍光セラミック板を下ろすことにより放射光を照射することで光軸位置を測定する装置。2 か所に設置する。	第 1.6 項
アブソーバ HX 型 (ABS-HX)	1 式	ビームライン不使用時に放射光ビームを遮る装置、放射光使用時にはマスクとしての機能を有する。放射光による熱負荷は水冷却された GlidCop で受ける。	第 1.7 項
鉛コリメータ	1 式	鉛ブロックにより散乱 X 線、制動 γ 線を吸収する装置。	第 1.8 項
可動マスク HX 型 (MVX)	1 式	水冷却された無酸素銅を使用して放射光に空間的な制限を加え、不要な放射パワーを取り除く装置。	第 1.9 項
XY スリット HX 型	1 式	2 台の受光により、ビーム利用実験に使用されない放射光部分をカットする装置。水冷された XY スリット受光部 (L 型スリット u, d)、精密駆動ステージ及びベローズパイプと支持台から構成される。受光部は、基本的には冷却水により冷却する。	第 1.10 項
ビームシャッター (BS)	1 式	タングステンブロックを光軸上に下ろすことにより実験ホール内に放射線が漏洩しないようにする装置。	第 1.11 項
ゲートバルブ	4 台	フロントエンドの真空系を分割するためのバルブ。VG1, 2, 3, 4 の 4 台で構成される。	第 1.12 項
シールド壁貫通管	1 式	放射光を実験ホールに取り出すためリングトンネルのシールド壁を貫通する真空配管。	第 1.13 項
光電子モニター	1 式	XY スリット受光部等の駆動可能な高熱負荷機器を、光軸に対して軸調整する時に使用する装置。	第 1.14 項
真空ベローズ	1 式	各真空装置部を連結するとともに、ベークキング時の熱膨張を吸収する。	第 1.15 項
ニップル	1 式	各真空装置部を連結する。	第 1.16 項

表 2: ビーム架台部構成機器

機器名	数量	詳細仕様書
共通ビーム支持架台	4 台	第 2.1 項
共通ビーム支持架台簡易型	1 台	第 2.2 項
壁外ビーム架台	1 台	第 2.3 項
共通ビーム	10 本	第 2.4 項

2. 搬入

工場内試験等の終了後、納入場所に輸送、搬入すること。輸送、搬入にあたっては、装置の性能を損なわないよう十分注意すること。重量物、長尺物の搬入には、地下 1 階連絡通路を利用することが可能である（図 B）。耐荷重、稼働範囲等、QST 担当者に確認し安全に作業を行うこと。

3. 現地据付・調整

フロントエンド機器の据付・調整は、以下の項目により構成される。各項目の詳細は「III. 詳細仕様書」を参照すること。なお、ナノテラスの搬入及び据付調整に当たっては、ナノテラス作業手引き、に基づくものとする。

- ① 現地作業を実施する場合は、1 週間前までに作業工程表を提出して確認を得ること。
- ② 作業責任者をおき、QST における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。
- ③ 作業は、QST の勤務時間内に実施すること。ただし、緊急を要し QST が承諾した場合は、所定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。
- ④ 他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく QST に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。
- ⑤ 作業責任者は、現地作業終了後、速やかに作業報告書を提出すること。
- ⑥ 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。
- ⑦ ナノテラスへの入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、ナノテラスの手続きを遵守すること。
- ⑧ 蓄積トンネル内の建屋内クレーンを利用することが可能である。耐荷重、稼働範囲等、QST 担当者に確認し安全に作業を行うこと。

4. アライメント

床面基準点を使ったアライメントには、トラッカー及び WILD 製 TM5100 相当の精度を有するトラン

シットを使用すること。

4.1. ビーム部

QST が指定する期間中（加速器停止期間）に、床面の光軸基準点(QST により打設済)を使って架台部（共通ビーム支持架台及び共通ビーム）の据付・アライメントを実施すること。

4.2. 真空装置

III. 詳細仕様書及びライン図(図 A)、ライン表(表 A)の配置に従って、真空装置の据付・アライメントを行うこと。

- ① XY スリット（精密駆動ステージも含む）、シールド壁貫通管については、床面基準点に対してアライメントすること。
- ② スクリーンモニタについては床面基準点でモニター中心をアライメントすること。
- ③ その他の機器については、基本的に共通ビーム基準に対してアライメントすること。
- ④ 次節のベーキング終了後、高熱負荷機器（可動マスク、アブソーバ、XY スリット）に対してリングトンネル内座標ネットワークを使い QST が行うレーザートラッカーを使った測量に基づき、最終アライメントを行うこと。

4.3. 真空排気、リークテスト、ベーキング及び真空立ち上げ

- ① ニップル、ベローズを含む全ての真空機器を締結後、貸与する移動式粗排気ポンプユニットを排気真空槽に取り付けて（VPC1 と VPC3 を想定）ベーキングの昇温開始までに十分な真空排気を行うこと。真空排気に必要な一切の部品（ボルト、ナット、ワッシャ、ガスケット、金属フレキ配管等）を準備すること。ベーキングに必要な電力はリングトンネル内の分電盤から供給される。なお、分電盤から各機器のヒータへ効率よく電力を供給するための中継の役割を果たすベーキング用温度調整機能付きヒーターコントローラを準備すること。ただし、ベーキングに必要な電力等が合致すれば QST のベーキング用温度調整機能付きヒーターコントローラを貸与する。
- ② ベーク時に他各部の熱膨張により損傷することがないように措置を講ずること。
- ③ シースヒータが不足しているか、あるいは取り付けられていない箇所に貸与するテープヒータを取り付けること。また、熱電対を取り付けること。なお、熱電対はシースヒータに接触させないこと。
- ④ ベーク対象機器を、追加したヒータや熱電対の外側からアルミホイルで覆うこと。
- ⑤ ヒータに通電し漏電等の問題がないことを確認のうえ、低温でプリベーキングを行うこと。
- ⑥ ベーキング開始後、昇温速度が 50 °C/時間以下程度となるようベーキングコントローラの温調器の温度を設定すること。ベーキング定常温度は 200～250 °C とすること。機器ごとのベーキング定常温度は別途打ち合わせのうえ決定する。
- ⑦ 定常温度に到達後、36 時間以上保持すること。この間、予期しない温度上昇、低下、ほか火災等の異常がないことを監視すること。

- ⑧ ベーキング終了前に各種機器のガス出し、活性化(ポンプ類)を行うこと。
- ⑨ ベーキング終了時にイオンポンプの運転を開始すること。
- ⑩ ベーキングの終了時、降温速度が $-60\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{時間}$ 以下となるよう、ベーキングコントローラの温調器の温度を設定すること。降温速度がこれ以下まで低下した段階でベーキング電源を切り、自然冷却とすること。
- ⑪ 真空槽の降温中に粗排気セットの圧力計を監視し、約 10^{-5} Pa 以下に到達した段階でメタルバルブを規定トルクで閉止すること。
- ⑫ メタルバルブの閉止後は設置された真空ゲージを短時間運転し、適宜圧力を読み取ること。これは、圧力が高い段階で真空ゲージを運転することによる損傷を防ぐための措置である。真空ゲージの値が 10^{-5} Pa 以下となった段階で、同真空ゲージを連続運転とすること。
- ⑬ 真空ゲージの値が $3\times 10^{-6}\text{ Pa}$ 以下となった時点で、真空ゲージのコントローラを操作してガス出しを行うこと。
- ⑭ 各部が概略室温になるまで、自然冷却開始後 12 時間以上放置すること。その時点で真空ゲージの値が $5\times 10^{-8}\text{ Pa}$ 以下になっていることを確認すること。圧力がこの値を上回っている場合はリークが疑われるので、適切な処置をとること。方法については別途協議する。
- ⑮ リーク量が許容値以下であることを確認すること。なお、ヘリウムリークディテクタ及びスプレーガンを備えたヘリウムガスポンプを貸与する。

5. 遮蔽機器の取り付け

- ① 鉛コリメータの遮蔽体構造物を III. 詳細仕様書 第 1.8 項に基づき組み立てること。
- ② シールド壁貫通管の周りを鉛で隙間無く埋めること。鉛を埋める範囲は、リングトンネル側 408 mm 角開口(奥行 300 mm)の全域とする。
なお、鉛の設置はベーキング後に行うこと。

6. 冷却水・圧空配管敷設

- ① III. 詳細仕様書 第 3 項に基づき、冷却水母配管を敷設するとともに、冷却水が必要な真空機器に枝配管を敷設すること。
- ② III. 詳細仕様書 第 4 項に基づき、圧空母配管を敷設するとともに、圧空が必要な真空機器に枝配管を敷設すること。

7. 制御系敷設

III. 詳細仕様書 第 5 項に基づき、フロントエンドの制御に必要な各種制御装置が収納された FE 主制御ラックを内周通路の指定場所に設置すること。加速器インターロックシステムへの接続も含め、フロントエンドの制御に必要な全てのケーブルを敷設すること。

8. 最終アライメント

すべての機器の設置しベーキング・真空立ち上げを行った後、リングトンネル内ネットワークに基づき QST が行うレーザートラッカーを使った測量に基づき、最終アライメントを高熱負荷機器(可動マスク、アブソーバ、XY スリット、)に対して実施すること。

9. 試験検査

本装置に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に検査要領書を作成し提出するものとする。

9.1. 受注者工場における試験

受注者工場において真空装置ごとに、「III. 詳細仕様書」に記載する試験を行い、その結果を試験検査成績書にとりまとめて QST に提出すること。なお、試験は必要に応じて、QST 担当者の立会いのもとで行うものとする。

9.2. 現地における試験

受注者工場において真空装置ごとに、「III. 詳細仕様書」に記載する試験を行い、その結果を試験検査成績書にとりまとめて QST に提出すること。なお、試験は必要に応じて、QST 担当者の立会いのもとで行うものとする。

① 設置精度の試験

本仕様書記載の設置精度確認のために必要な試験を行う。なお、設置精度は基本的にベーキング終了時の状態で満足するものとする。さらに主要機器については、レール基準面から各機器基準フランジ面あるいは本体基準面までの寸法を計測のうえ、提出すること。

② リーク試験

全機器を締結後、ヘリウムリークディテクタにてリーク試験を行うこと。

③ 超高真空試験

温度調節器などにより到達温度を管理のもと 48 時間以上の 250°C (真空装置の種類によっては 150°C や 200°C 前後。) 加熱排気を実施した後、NEG ポンプの活性化、タイバックポンプのフラッシングを実施し、240 時間経過後の各排気真空槽におけるヌード型 BA ゲージの指示値が、下表に示す仕様値を満足していることを確認すること。下表の値に達し得ない場合は、原因を究明し、不良箇所を特定した上で QST 担当者の指示を仰ぐこと。QST 担当者が、加熱排気時間の不十分等、据付・調整作業によることが原因と判断した場合には、必要に応じて再加熱排気処理等を

施すこと。また、この試験によって真空装置の本仕様書記載の精度が損なわれた場合には、修理や交換等の処置を講ずること。

表：真空仕様値

測定場所(ケージ)	仕様値
IG1 (EVPC)	4×10^{-8} Pa 以下
IG2 (VPC1)	4×10^{-8} Pa 以下
IG3 (VPC2)	6×10^{-8} Pa 以下
IG4 (VPC3)	6×10^{-8} Pa 以下

④ 冷却水配管試験

冷却水配管に漏洩がないことを確認するため、窒素ガスなどによる加圧漏洩試験をスヌープを使って行うこと（耐圧 1MPa）。また、「III. 詳細仕様書第 3.4 項」に記載の流量確認も行うこと。

⑤ 圧空配管試験

圧空配管に漏洩がないことを確認するため、窒素ガスなどによる加圧漏洩試験をスヌープを使って行うこと（耐圧 0.8 MPa）。また、「III. 詳細仕様書 第 4.6 項」に記載の漏洩試験を行うこと。

⑥ 動作試験

ステッピングモータ駆動装置、圧空駆動装置、ゲートバルブ及び高速シャッター等の動作試験を通水状態で行うこと。また、駆動部に取り付けられた金属フレキホースが駆動時の滑らかな動きを妨げていないことを確認すること。さらに、継手部に無理な負担が掛かっていないことも確認すること。

⑦ インターロック信号試験

冷却水接点、圧空接点、真空系及びリミットスイッチによるステータス信号など各種信号が正しく出力されていることを確認するとともに、支給品である FE/PLC 制御盤との取合い試験を行うこと。

⑧ 最終アライメント試験

II 技術仕様 第 8 項に記載の最終アライメントを行い、本仕様書記載の設置精度確認のために必要な試験を行うこと。

(要求者)

部課(室)名：NanoTerasu センター

高輝度放射光研究開発部

加速器グループ

氏 名：安居院 あかね

III. 詳細仕様書

1. 真空装置部

各仕様は、「II. 技術仕様、第 4.2 項」に示す真空装置部の 1 式あたりのものであり、また、各機器の内周通路側設置機器への配線作業、冷却水枝配管、圧空枝配管を含む。各機器の内周通路側設置機器への配線作業は、「第 5 項 フロントエンド制御盤部」の記述と重なる部分があるので注意すること。

1.1. 超高真空排気ユニット(VPC1, VPC2, VPC3、EVPC)

1.1.1. 概要

超高真空排気ユニットは超高真空を得ることを目的とする装置であり、3 種類の排気真空槽 (VPC1, VPC2, VPC3: 各 1 台(図 1-1(a)~(c)HX 型)) と端部排気真空槽 (EVPC: 1 台(図 1-1(d))) から構成され、ゲートバルブで区切られる各真空セクションに配置される。本ユニットは、圧力の絶対値だけでなく高度な清浄度を要求される蓄積リングに直結するため、製作時に真空内面を汚したり傷つけたりすることのないよう十分に留意すること。

VPC は主排気ポンプであるノーブルポンプを加工し、放射光がポンプ内を通過できる構造を有する。補助ポンプとしてタイバックポンプを有する。EVPC は、光軸上におかれた専用チェンバにノーブルポンプをオフセットさせて取り付ける構造とし、主排気ポンプは NEG ポンプとする。VPC、EVPC とともに電離真空計、真空封止用メタルバルブ、移動式粗排気ポンプユニット接続用アングルバルブ等の真空部品が取り付けられる。

1.1.2. ユニット構成部品

1.1.2.1. VPC1

VPC1(1 台)は以下①~⑦で構成される。(図 1-1(a))

- ① 排気真空槽 A 型本体(図 1-1(e)) :1 台
面間寸法 : 260 mm (参考値)
材質 : SUS304、SS
ビーム軸フランジ: ICF70/ICF70 とする。
ノーブルポンプ (キャノンアネルバ製 110L/s ノーブルポンプ特注品(相当品))
以下②~⑦を装備すること。
- ② タイバックポンプ :2 個
キャノンアネルバ製タイバックポンプ/956-7040 相当品とする。

延長ニップルを付属すること。

- ③ 光電子抑止型ゲージポート (図 1-1(h)) :1 個
寸法 : 217L×217H×114W (参考値)
材質 : SUS304, SS,
光電子抑止にはフェライト磁石を用いること。
- ④ ICF114 フランジ付きヌード型 BA ゲージ :1 個
キャノンアネルバ製 NIG-2TF/954-7903 相当品とする。
- ⑤ 2.5 インチオールメタルバルブ :1 個
キャノンアネルバ製/951-7152 相当品とする。
- ⑥ 2.5 インチボタンバルブ :1 個
キャノンアネルバ製/V-065LV-MMI DN65 手動 L 型バルブ MSB 相当品とする。
- ⑦ 高速シャッター用真空センサー(冷陰極型) :1 個
VAT 製 770SH-99NN 相当品とする。

1.1.2.2. VPC2

VPC2(1 台)は以下①～⑥で構成される。(図 1-1(b))

- ① 排気真空槽 A 型本体 (図 1-1(f)) :1 台
面間寸法 : 250 mm (参考値)
材質 : SUS304, SS
ビーム軸フランジ ICF70/ICF70
ノーブルポンプ: キャノンアネルバ製 110L/s ノーブルポンプ特注品(相当品)
以下②～⑥を装備すること。
- ② タイバックポンプ :2 個
キャノンアネルバ製タイバックポンプ/956-7040 相当品
延長ニップルを付属すること。
- ③ 光電子抑止型ゲージポート (図 1-1-1(h)) :1 個
寸法 : 217L×217H×114W (参考値)
材質 : SUS304, SS
光電子抑止にはフェライト磁石を用いること。
- ④ ICF114 フランジ付きヌード型 BA ゲージ :1 個
キャノンアネルバ製/NIG-2TF/954-7903 相当品
- ⑤ オールメタルバルブ :1 個
キャノンアネルバ製/951-7150 相当品
ICF114/70 変換フランジを付属すること。
- ⑥ ポリイミドバルブ :1 個
キャノンアネルバ製/951-7120 相当品

1.1.2.3. VPC3

VPC3(1 台)は以下①～⑦で構成される。(図 1-1(c))

- ① 排気真空槽 A 型本体 (図 1-1(f)) :1 台

面間寸法：250 mm（参考値）、

材質：SUS304、SS

ノーブルポン（キャノンアネルバ製 110L/s ノーブルポンプ特注品(相当品)）

ビーム軸フランジ；ICF70/ICF70

以下②～⑦を装備すること。

- ② タイバックポンプ :2 個
キャノンアネルバ製タイバックポンプ/956-7040 相当品
延長ニップルを付属すること。
- ③ 光電子抑止型ゲージポート（図 1-1-1(h)） :1 個
寸法：217L×217H×114W（参考値）
材質：SUS304, SS
光電子抑止にはフェライト磁石を用いること。
- ④ ICF114 フランジ付きヌード型 BA ゲージ :1 個
キャノンアネルバ製 NIG-2TF/954-7903 相当品とする。
- ⑤ オールメタルバルブ :1 個
キャノンアネルバ製 951-7150 相当品
ICF114/70 変換フランジを付属すること。
- ⑥ ポリイミドバルブ :1 個
キャノンアネルバ製 951-7120 相当品
- ⑦ 高速シャッター用真空センサー(冷陰極型) :1 個
VAT 製 770SH-99NN 相当品とする。

1.1.2.4. 端部排気真空槽（EVPC）

EVPC(1 台)は以下①～⑥で構成される。(図 1-1(d))

- ① チェンバ付き端部排気真空槽本体（図 1-1(g)） :1 台
面間寸法：300 mm（参考値）
材質:SUS304、SS
ノーブルポンプ；キャノンアネルバ製 60L/s ノーブルポンプ特注品(相当品)
及び、これを光軸からオフセットさせる、ビーム軸フランジ ICF152/ICF152、
以下②～⑥を装備すること。
- ② NEG ポンプ :1 個
SAES 製 CapaciTorr Z200(ICF70 付)相当品
活性化に用いる SAES 製 CapaciTorr D200 用制御装置は貸与する
延長ニップルを付属すること。
- ③ 光電子抑止型ゲージポート（図 1-1(h)） :1 個
寸法：217L×217H×114W（参考値）
材質：SUS304, SS
光電子抑止にはフェライト磁石を用いること。
- ④ ICF114 フランジ付きヌード型 BA ゲージ :1 個

キャノンアネルバ製 NIG-2TF/954-7903 相当品とする。

- ⑤ オールメタルバルブ : 1 個
キャノンアネルバ製 951-7150 相当品
ICF114/70 変換フランジを付属すること。
- ⑥ ポリイミドバルブ : 1 個
キャノンアネルバ製 951-7120 相当品

1.1.3. ユニット機器共通仕様

- ① ビーム軸フランジの溶接取り付け精度はチェンバ軸に対し±0.2 mm 以下（目標値）であること。
- ② VPC1, 2, 3 は、共通ビームを用いたアライメントに適合した専用架台を有していること。
- ③ EVPC のノーブルポンプは光軸からオフセットしており、本仕様書内「第 2 項 ビーム架台部」に記載の 2 本の共通レールで構成される架台システムに搭載できないので、共通レールの使用は 1 本とし EVPC のノーブルポンプ本体を床面から支持するための架台を別途設けること。また、当該架台は、近隣の他の真空機器の位置調整機能付き架台となる構造も有していること。なお、建設後にも基準面が残るようにすること。
- ④ ノーブルポンプは、特に下記の仕様を満足すること。
- ・ ON LOCK 機能（停電後の復電時に自動復帰する機能）を有していること。
 - ・ 1 台のノーブルポンプのみ単独にオフする際、コントローラの主電源もオフできること（誤操作による高圧出力によって人的災害が引き起こされる可能性を防ぐため）。
- ⑤ 予備ポート及びバイトンバルブの粗排気接続用フランジには、ブランクフランジを取り付けて納入すること。
- ⑥ 出荷前に単体でベーキングを行い、ベーキング後の到達圧力が 3×10^{-8} Pa 以下であることを確認し、真空封じきりの状態で出荷すること。真空封止部には、ガス導入バルブ（ICF70 フラン付、ベローズ軸シール方式）を使用するなど、ベント時に操作し易い構造であること。

1.1.4. ユニット機器据え付け

- ①アライメント基準はビーム軸フランジ中心とすること。
- ②ビーム軸フランジの設置精度はレール基準のビーム軸に対して±0.2 mm 以下であること。
- ③ゲージポートのコネクタ取合部は、ケーブルの曲げ弾性等による負荷がかからないようにすること。

1.1.5. 内周通路側制御部設置機器

1.1.5.1. VPC1

- ① ノーブルポンプコントローラ（キャノンアネルバ製 P-521NP 相当品） : 1 台
- ② 真空ゲージコントローラ（キャノンアネルバ製/M-923DD 相当品） : 1 台
- ③ サブリメーション制御装置（キャノンアネルバ製/SR-TVP-050 相当品）（共用） : 1 台

④ 高速シャッターコントローラ (VAT 製/770VF-16NN-AHN1 相当品) : 1 式

1.1.5.2. VPC2

- ① ノーブルポンプコントローラ (キャノンアネルバ製 P-521NP 相当品) : 1 台
- ② 真空ゲージコントローラ (キャノンアネルバ製 M-923DD 相当品) : 1 台
- ③ サブリメーション制御装置 (キャノンアネルバ製 SR-TVP-050 相当品) (共用) : 1 台

1.1.5.3. VPC3

- ① ノーブルポンプコントローラ (キャノンアネルバ製 P-521NP 相当品) : 1 台
- ② 真空ゲージコントローラ (キャノンアネルバ製 M-923DD 相当品) : 1 台
- ③ サブリメーション制御装置 (キャノンアネルバ製 SR-TVP-050 相当品) (共用) : 1 台
- ④ 高速シャッターコントローラ (VAT 製 770VF-16NN-AHN1 相当品) : 1 式

1.1.5.4. 端部真空廃棄槽(EVPC)

- ① ノーブルポンプコントローラ (キャノンアネルバ製 P-511NP 相当品) : 1 台
- ② 真空ゲージコントローラ (キャノンアネルバ製 M-923DD 相当品) : 1 台

1.1.6. 内周通路制御部への通線

1.1.6.1. PC1

- ① ノーブルポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本
- ② 真空ゲージ用ケーブル (ゲージコントローラへ) : 1 本
- ③ タイバックポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本
- ④ 高速シャッター用センサーケーブル (緊急遮断シャッターシステムへ) : 1 本

1.1.6.2. VPC2

- ① ノーブルポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本
- ② 真空ゲージ用ケーブル (ゲージコントローラへ) : 1 本
- ③ タイバックポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本

1.1.6.3. VPC3

- ① ノーブルポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本
- ② 真空ゲージ用ケーブル (ゲージコントローラへ) : 1 本
- ③ タイバックポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本
- ④ 高速シャッター用センサーケーブル (緊急遮断シャッターシステムへ) : 1 本

1.1.6.4. EVPC

- ① ノーブルポンプ用ケーブル (ポンプコントローラへ) : 1 本
- ② 真空ゲージ用ケーブル (ゲージコントローラへ) : 1 本

1.2. フォトンダクトアブソーバ 114 型(PDA)

1.2.1. 概要

PDA は、ビームライン閉鎖時に銅ブロックを光軸上に下ろすことにより、GV1 への偏向電磁石からの漏洩光照射を防ぐ。PDA の挿入は圧空駆動で行う。水冷機構を有する。材質は SUS304、SS、無酸素銅 (OFHC/C1011) とする。(図 1-2(a))

1.2.2. 構成

- ① PDA チェンバは、面間寸法:220 mm (参考値)、ビーム軸フランジ: ICF114 (参考値) とする。
- ② 受光体部は 62W×80H×30t(参考値) とする。
- ③ 材質は無酸素同(OFHC/C1011), SUS304, SS
- ④ PDA チェンバは、エアシリンダ、ベローズを有する。
- ⑤ PDA チェンバと、下流側に接続される第 1.3 節の前置マスクをサポートするための架台部 (水平・垂直方向の位置調整機能付き) を設けること。詳細は別途協議する。

1.2.3. 仕様

- ① PDA 開閉駆動部は 50 mm 以上のストロークを備え、溶接ベローズ及びスピード制御付圧空シリンダ(エアシリンダ)方式を採用し、動作時間を 2~3 秒程度に調整できる構造であること。
- ② PDA の開状態と閉状態を検出するために高耐久型リミットスイッチを設置すること。
- ③ 加速器/真空制御システムに出力するために、上記②に記載のもの以外に、PDA の開状態信号用高耐久型リミットスイッチを開側に設置すること。
- ④ 受光部材質は無酸素銅 (OFHC/C1011) とする。
- ⑤ 水冷配管には 10 mm 銅パイプ又は二重管式冷却機構を採用し、継手は金属製食い込み継手 (Swagelok) を使用すること。
- ⑥ 放射光が照射される領域の背面に冷却水配管を設けないこと。
- ⑦ PDA を開の状態に固定するためのメカロック機能を有していること。
- ⑧ ビーム軸フランジの溶接取り付け精度はチェンバ軸に対して±0.2 mm 以下 (目標値) であること。
- ⑨ PDA 閉状態の受光体軸精度はチェンバ軸に対して±0.2 mm 以下 (目標値) であること。
- ⑩ ベローズ部は、材質:SUS316L、変位量 50 mm 以上、耐用回数(寿命)10,000 回以上、耐熱温度 250°C であること。
- ⑪ 開閉の動作時間が 2~3 秒程度で調整できる構造であること。

1.2.4. 据付仕様

- ① 第 1.3 節の前置マスクと一体で支持すること。
- ② アライメント基準はビーム軸フランジ中心とし、前置マスクと一体で調整すること。
- ③ ビーム軸フランジの設置精度は床面基準点に基づいたビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下（目標 ± 0.1 mm 以下）であること。
- ④ 冷却水母配管からの枝配管を行うこと。
- ⑤ 冷却水路の OUT 側に接点付き流量計を設置すること。なお、PDA の流量計接点信号を蓄積リング真空制御系に取り込むため、QST が指定する取り合いコネクタ又は信号線（リングトンネル内真空冷却系ヘッダー近傍）に接続すること。
- ⑥ 圧空母配管からの枝配管を行うこと。
- ⑦ 開閉の動作時間を 2～3 秒で調整すること。

1.2.5. 内周通路側制御部への通線作業

- ① エアシリンダ駆動用及びリミットスイッチ用ケーブル (FE 主制御ラックへ) : 1 本
- ② PDA の開状態信号用高耐久型リミットスイッチ用ケーブル
(加速器真空系取り合い端子台へ。最大 100 m 程度) : 1 本
- ③ 水流量接点 (加速器真空系取り合い端子台へ。最大 100 m 程度) : 1 本

1.3. 前置マスク HX 型

水冷銅ブロックにより不要な放射光を吸収する。

1.3.1. 仕様 (図 1-3(a))

- ① フランジは、面間寸法 : 130 mm (参考値)、ビーム軸フランジ : ICF114/ICF70 とする。また、
入口開口 : 50 (水平) \times 40 (垂直) 公差 $+0.4/-0$ (参考値)
出口開口 : 18 (水平) \times 18 (垂直) 公差 $+0/-0.4$ (参考値)
とする。材質は SUS304、無酸素銅 (OFHC/C1011)
- ② 前置マスクと、上流側に接続される PDA をサポートするための架台部 (水平・垂直方向の位置調整機能付き) を設けること。隣接する加速器構成機器 (仕様外) との干渉が厳しいので、詳細は別途協議する。
- ③ ビーム軸フランジの取り付け精度はマスク開口軸に対し ± 0.2 mm 以下とする。
- ④ 冷却水入出部は金属製食い込み継手 (Swagelok) を採用すること。

1.3.2. 据付仕様

- ① アライメント基準はビーム軸フランジ中心とし、PDA と一体で調整すること。

- ② ビーム軸フランジの設置精度は床面基準点に基づいたビーム軸に対して±0.2 mm 以下（目標 ±0.1 mm 以下）であること。
- ③ 冷却水母配管からの枝配管を行うこと。
- ④ 冷却水路の OUT 側に接点付き流量計を設置すること。

1.3.3. 内周通路側制御部への通線

- ① 水流量接点 (FE 主制御ラックへ) : 1 本

1.4. 高速ビームシャッター (FCS)

1.4.1. 概要

真空漏れ事故時シャッターを高速に（10 ミリ秒以下）下ろすことによって大気の蓄積リング真空系への流入を阻止する。

1.4.2. 構成

- ① 高速シャッター (FCS) (VAT 製 77332-CE44 相当品) : 1 個
- ② 支持台 (FCS 用バネ式台座) (図 1-4(a)) : 1 個

1.4.3. 仕様

- ① 高速シャッター用真空センサーのトリガー信号を受けてからシャッター閉止までの時間が 10 ms 以下であること。
- ② 圧空作動式であり、複動シリンダ、開閉リミットスイッチ付き、DC24V 電磁弁付きであること。
- ③ シャッターの駆動はスロットシャッター方式であること。
- ④ ボンネットのシールはメタルであること。また軸シールはベローズであること。
- ⑤ 材質はステンレス製であること。
- ⑥ ボディーのリーク量は 1×10^{-11} Pa·m³/sec 以下であること。
- ⑦ 耐放射線性能として、 10^8 Gy (シャッターボディー)、 10^4 Gy (圧空アクチュエータ) 以上であること。
- ⑧ サイズは ICF70 (DN40) で、面間距離は 60 mm であること。また、開口サイズは 38 mm 以上であること。
- ⑨ バルブボディーの耐熱温度は 300°C であること。
- ⑩ 専用の緊急遮断システムコントローラによる制御が可能であること。

1.4.4. 据付

- ① 共通レールへの取り付けに際しては、FCS 用バネ式台座で支持すること。(図 1-4(a))

- ② 圧空母配管から枝配管を行うこと。

1.4.5. 内周通路側制御部設置機器

- ① 高速シャッターコントローラ (VAT 製 770VF-16NN-AHN2 相当品) :1 式

1.4.6. 内周通路側制御部への通線

- ① 高速シャッター駆動用ケーブル (緊急遮断シャッターシステムへ) :1 本

1.5. 光軸調整用フィルタ(ADJFIL)

1.5.1. 概要

圧空動作により各種フィルタを挿入し放射光の低エネルギー成分を除去する。発生した熱は水冷により取り去る。専用の真空チェンバにスクリーンモニタ(SCM1)と共に取り付けられる。低蓄積電流モードの光軸確認時にのみ使用する。(図 1-5(a))

1.5.2. 構成

- ① 銅及びアルミフィルタを切り替えられる ADJFIL を ICF70 付きサファイアビューイングポート付き ICF70 取合の真空チェンバ(ADJFIL 用チェンバ)に装備すること。
- ② ADJFIL 用チェンバには、後述の SCM1 をビューイングポートも含めて取り付け可能なこと。
- ③ 材質は SUS304、SS、OFHC (水冷パイプ)、銅、アルミとする。
- ④ 圧空シリンダーを有すること。

1.5.3. 仕様

- ① フィルタ切り替え機構には圧空シリンダーを用いること。2 段式エアシリンダー駆動により、1 軸で 2 つのフィルタ部を独立に選択できる (IN1、IN2、OUT の 3 位置の選択) こと。
- ② ADJFIL/OUT 時におけるフィルタ部の最下点と光軸とのクリアランスが 16mm 以上確保出来る構造、ストロークとすること。
- ③ 直線導入器は、各フィルタ部の停止位置を微調できる機能を有すること。
- ④ 真空外からフィルタの中心位置を光軸中心位置にあわせるための位置調整 (水平・垂直方向) が可能であること。フィルタ材は銅板 (厚さ 1 mm ; 参考値)、アルミ板 (厚さ 1 mm ; 参考値) を使用すること。
- ⑤ 冷却水入出部は金属製食い込み継手(Swagelok)を使用すること。
- ⑥ 開⇄上部フィルタ、上部フィルタ⇄下部フィルタ間の駆動時間を 1~2 秒で調整できる構造であること。
- ⑦ 受光部ホルダーと水冷パイプとのロウ付けは、十分な熱接触が得られるように隙間なくなされて

いること。

- ⑧ ビーム軸フランジ（ICF70）の溶接取り付け精度はチェンバ軸に対して ± 0.2 mm 以下（目標値）であること。
- ⑨ チェンバを真空引きした際のフィルタ取り付け開口軸の変位量が、水平・垂直方向とも ± 0.1 mm 以下を達成できる構造であること。
- ⑩ 水平、垂直の位置調整機構が付いた台座を設けること。
- ⑪ 水冷却は継手を使用しない一筆書き構造とし、パイプの材質は無酸素銅とすること。
- ⑫ ベローズ部の耐用回数(寿命)は 10,000 回以上であること。

1.5.4. 据付仕様

- ① 出荷前に、ビーム軸フランジ基準に対してフィルタ取り付け開口軸中心が ± 0.1 mm 以下になるように調整すること。
- ② ビーム軸フランジの設置精度はレール基準のビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下であること。
- ③ 冷却水母配管からの枝配管を行うこと。
- ④ 冷却水路の OUT 側に接点付き流量計を設置すること。
- ⑤ 圧空母配管からの枝配管を行うこと。
- ⑥ 開⇄上部フィルタ、上部フィルタ⇄下部フィルタ間の駆動時間を 1~2 秒で調整すること。

1.5.5. 内周通路側制御部への通線

- ① エアシリンダ駆動及びリミットスイッチ用ケーブル（FE 主制御ラックへ） : 1 本
- ② 水流量接点（FE 主制御ラックへ） : 1 本

1.6. スクリーンモニタ(SCM)

1.6.1. 概要

圧空動作によりアルミナ蛍光板を出し入れし、必要に応じて放射光を照射することにより光軸位置を測定する。専用の真空チェンバに取り付けられる。アブソーバ上流に設置するものを SCM1、ビームシャッター下流に設置するものを SCM2 とする。低蓄積電流モードの光軸確認時にのみ使用する。(図 1-6(a), (b))

1.6.2. 構成（1 台あたり）

- ① SCM の受光部はアルミナ蛍光板（Chromox 社 AF995R 相当品）とする。他の材質は SUS304、SS とする。
- ② 受光部を出し入れ機構は圧空シリンダとする。

- ③ SCM2 は ICF70 付きサファイアビューイングポート付き SCM 用真空チェンバに取り付けること。
SCM1 は（ビューイングポートも含めて）1.5 節記載の ADJFIL 用チェンバに取り付けること。
- ④ アルミナ蛍光板を観察するカメラ（仕様外）による観測が可能であること。カメラ（仕様外）取付のための支持台を持つこと。

1.6.3. 仕様

- ① 直線導入器は検出部入側の停止位置を微調できる機能（ストッパー位置可変）を有すること。
- ② ビーム軸フランジの溶接取り付け精度はチェンバ軸に対して±0.2mm 以下（目標値）であること。
- ③ チェンバを真空引きした際のアルミナ蛍光板中心の変位量が、水平・垂直方向とも±0.1 mm 以下であること。
- ④ アルミナ蛍光板の取り付けはビーム軸に対して 45° とし、90° 方向からのカメラ（仕様外）による観測が可能であること。
- ⑤ 開閉駆動部は 40 mm 以上のストロークを備え、スピード制御付圧空シリンダ方式を採用し動作時間を 2～3 秒に調整できる構造であること。
- ⑥ 水平、垂直の位置調整機構が付いた台座を設けること。（図 1-6(b)）
- ⑦ ベローズ部の耐用回数（寿命）は 10,000 回以上であること。

1.6.4. 据付

- ① 出荷前に、ビーム軸フランジ基準に対してアルミナ蛍光板中心が±0.1 mm 以下になるように調整すること。
- ② ビーム軸フランジの設置精度はレール基準のビーム軸に対して±0.2 mm 以下であること。
- ③ アルミナ蛍光板中心が床面基準点に基づいたビーム軸に対して±0.2 mm 以下であることを確認すること。
- ④ 圧空母配管からの枝配管を行うこと。
- ⑤ 開閉の動作時間を 2～3 秒で調整すること。

1.6.5. 内周通路側制御部への通線

- ① エアシリンダ駆動及びリミットスイッチ用ケーブル（FE 主制御ラックへ） : 1 本
- ② Web カメラ用 LAN ケーブル（FE 主制御ラックへ） : 1 本

1.7. アブソーバ(ABS) HX 型

1.7.1. 概要

ABS 本体は圧空機構により駆動ビームライン不使用時に放射光ビームを遮る。また使用時にはマスクとして機能する。放射光による熱負荷は水冷却された GlidCop で受けて冷却する。ABS

の上下流には ASB 用ベローズニップルを設置する。ニップルは AB の駆動に支障を与えないこと。また、駆動しても放射光ビームが当たらない寸法・形状であること。(図 1-7(a)～(c))

1.7.2. 構成

1.7.2.1. 本体部

- ① 寸法：780L×80W×80H（参考値）、ビーム軸取合フランジ ICF114/ICF114 とする。(図 1-7(a), (b))
- ② 材質は GlidCop-AL15（受光部）、Cu コイル、SUS304、SS とする。
- ③ 駆動用圧空シリンダ、駆動位置を取り出すリミットスイッチを有すること。

1.7.2.2. 冷却水流路

- ① 冷却水流路は内径 10 mm とし、流路内には直径 1.5 mm でピッチ 10 mm、コイル外径 10 mm の銅線コイルをロウ付けにより取り付け、流路方向に沿って円周方向に一ヶ所固定すること。また、本固定が健全なものであることを工業用内視鏡等により確認すること。
- ② 冷却水路は、図 1-7(b)を参考に複数本設け、それらが直列となるような構造とすること。出荷前に所定の圧力条件 ($\Delta P=0.5$ MPa) において所定の流量 (20 L/min 以上) が流れることを確認すること。
- ③ 冷却水入出部は 金属製食い込み継手(Swagelok)を使用すること。冷却水入出部の短管と本体は EB 溶接で（ねじ込み式は不可）接続すること。

1.7.2.3. ヒータ

- ① ベーキング用のプレートヒータ等を受光部本体外面に取り付けること。
- ② ベーキング時の GlidCop の最大温度は 180°Cとするが、ヒータ自身の能力としては 250°C までベーキング可能であること。

1.7.2.4. 温度センサー

- ① 温度センサーとして JIS-K タイプで外径 1.6 mm の非接地型シース熱電対 4 個（参考値）をバヨネット型フィッティング等により本体に固定すること。
- ② 熱電対補償導線と専用コネクタ（オメガ熱電対コネクタ相当品）を機器近傍に接続させること。なお、端部には識別可能なタグを取り付けること。

1.7.2.5. 駆動

- ① アブソーバの水平を保って上下方向に 18 mm（参考値）の移動を行う機構として、上下限に機械的なりミッタと上下位置をステータス信号として取り出すことのできるリミットスイッチを設けること。上下限リミットスイッチは本体の上流側と下流側に各々 1 対設けること。
- ② 停止精度は ± 0.2 mm 以下であること。
- ③ 動作時間は 0.5～3.0 秒で調整可能であること。但し設定値は別途協議する。
- ④ 電磁弁及びリミットスイッチ等の部品の選定には耐放射線性を考慮し、日本において容易に入手可能なものであること。
- ⑤ 繰り返し使用による位置ずれを防ぐため、リミットスイッチ用押板はリミットスイッチの先

端に対して垂直にあたること。

1.7.2.6. ABS用ベローズニップル部

- ① ASB本体部の直上流、直下流に1ずつ設置する。(図 1-7(c)) ABSの駆動に支障がなく、駆動により変形しても放射光ビームが当たらない寸法・形状であること。
- ② 材質はAM350(ベローズ)、SUS304(他)、接続フランジ: ICF70-RH、ICF114-FHとする。
- ③ 全長 240mm(自由長; 参考値)、ストロークは軸直角方向で 25 mm(上下方向に±12.5 mm)以上とする。
- ④ ベローズ部の耐用回数(寿命)は 1×10^6 回以上であること。

1.7.3. 仕様

- ① ABS本体のアライメント基準は、本体外面とすること。(内面のビーム軸と本体外面が一致していること)。
- ② ビーム軸フランジの本体基準面に対する溶接精度は、±0.2 mm以下であること。
- ③ 受光部テーパ部全域において、テーパ角が規定値以上に逸脱しない加工を行うこと。また、最小幅部の寸法は 0.5 mm程度以下とし、当該部を通過した放射光はクサビ板で受光すること。クサビ板の詳細は最大放射パワーにより決定すること。
- ④ 本体外面に、ビーム軸と基準面との実測寸法、およびシリアル No. を刻印すること。
- ⑤ 本体上面光軸上に、SMRが搭載可能なターゲット穴(φ4/H7)を2箇所以上設けること。また、本体上面は、ローリングを測定するための高精度水準器が使える水平基準面であること。
- ⑥ 加工方法によって完成品では確認できない部位に対しては、事前にモックアップ試験を行い、QST担当者の承認を得ること(過去の実績提示でも可)。
- ⑦ 納入前に単体ベーキング(24時間保持)を行い、所定の温度に上がることとリーク量が許容リーク量以下であることを確認すること。
- ⑧ 基準面となる本体外面が酸化・変色しないような梱包処置を行うこと(例えば、本体をビニール袋で2重に被い、シリカゲル等を入れたあとN₂で膨らませる等)。
- ⑨ 架台の柱には低熱伝導型スタット(図 1-7(d))を使用すること。

1.7.4. 据付

- ① 機器据付時: 本体外面基準面の設置精度は、レール基準のビーム軸に対して±0.2mm以下であること。
- ② 最終アライメントはQSTが行うレーザートラッカーを使った測量に基づき、実施すること。SMRの設置精度はトラッカ測量に基づいたビーム軸に対して±0.2 mm以下(目標±0.1 mm以下)であること。また、ピッチング及びヨーイングが±0.04 mm以下; 目標±0.02 mm以下とする。詳細はQST担当者と打ち合わせのうえ決定する。
- ③ 冷却水母配管からの枝配管を行うこと。母配管との取合バルブサイズは20A(3/4")とする。
- ④ 母配管からの枝配管はφ16 mmのBA管(SUS304)を使用し、アブソーバには20Aの金属フレキホース配管を用いて接続すること。接続部は金属製食い込み継手(Swagelok)を使用すること。

と。また、作業前に配管系統図を提出して承認を得ること。

- ⑤ 冷却水路の OUT 側に接点付き流量計を設置すること。
- ⑥ 圧空母配管からの枝配管を行うこと。
- ⑦ 開閉の動作時間を 1~2 秒で調整すること。

1.7.5. 工場出荷前試験

工場出荷前に下記試験等を行うこと。詳細は別途協議する。

① 外観・寸法試験

外観（特に真空内面）に有害な傷、変形、シミ・汚れ等のないことを確認すること。また納入仕様書に指示された主要寸法及び公差とおりにあることを確認すること。

② ヘリウムリーク試験

ベーキング前後においてヘリウムリーク試験を行い、リーク量が 1×10^{-11} Pa \cdot m³/sec 以下であることを確認すること。

③ 冷却水路耐圧・漏洩試験

N₂ ガス 1 MPa \cdot G で加圧し、スヌープ等で漏れがないこと、及び 30 分間放置して顕著な漏れ (-0.1 MPa \cdot G) がないことを確認すること。水を用いた同等の検査でも可とする。詳細は打ち合わせのうえ決定する。

④ 冷却水通水試験

所定の圧力条件（機器の出入口での $\Delta P=0.5$ MPa）において、所定の流量が（20 L/min 以上）流れることを確認すること。また、水温も記録すること。

⑤ ワイヤコイル形状確認試験

ロウ付け前にワイヤコイルが所定の形状で冷却流路内に挿入されていることを内視鏡等により確認すること。また、ロウ付け後においては、ワイヤコイルが流路壁に正常にロウ付けされていることと、ロウ材が流路を塞いでいないことを確認・記録すること。

⑥ 動作試験

ベーキング前後において、ベローズニップルを取り付け、真空引きを行った状態で動作試験（開閉を 200 サイクル）を行うこと。滑らかに所定のストロークを動作すること、上下停止位置の再現性、水平方向への倒れがないこと、またリミットスイッチの動作確認等を確認すること。

⑦ ベーキング用ヒータ通電試験

ベーキング用ヒータに通電を行い、ヒータ線と受光部が絶縁されていること、受光部が均一に昇温できることを確認する。なお、ベーキング時には冷却水路の真空排気を行った状態で実施すること。

⑧ 熱サイクル試験

受光部本体をベーキング用ヒータにより 180℃まで昇温させ、30 分保持後 50℃まで自然冷却させる作業を 3 回繰り返し、その後上記第②のヘリウムリーク試験を行うこと。

⑨ 受光部テーパ角度計測試験

受光部のテーパ角度が既定値以内であることを確認すること。

1.7.6. 内周通路側制御部への通線

- ① 水流量接点 (FE 主制御ラックへ) : 1 本
- ② 圧空シリンダ駆動及びリミットスイッチ信号 (FE 主制御ラックへ) : 1 本
- ③ 補償導線 (FE 主制御ラックへ) (参考値) : 4 本

1.8. 鉛コリメータ

1.8.1. 概要

30 cm 厚さの鉛ブロックにより散乱 X 線、制動 γ 線を吸収する。(図 1-8(a))

1.8.2. 仕様

- ① 寸法は装置全体 340L×300W×400H (参考値) とし、鉛ブロック部は 300L×200W×200H (プラス公差であること) とする。また、真空パイプは外径 25×内径 23×340L (参考値) とする。
- ② 材質は鉛、SUS304、SS とする。
- ③ 真空パイプには溝を設け、ベーキングヒータを埋め込むこと。
- ④ ビーム軸フランジの溶接取り付け精度はチェンバ軸に対し $\pm 0.2\text{mm}$ 以下であること。
- ⑤ 真空パイプのベーキング温度を測定するために熱電対 (K タイプ) をあらかじめ組み込んでおくこと。
- ⑥ 真空パイプは共通ビームから支持し、鉛ブロックは床から鉛ブロック支持部にて独立に支持する構造とすること。

1.8.3. 据付

- ① ビーム軸フランジの設置精度はレール基準のビーム軸に対して $\pm 0.2\text{ mm}$ 以下であること。
- ② 鉛ブロックが崩れ落ちないように崩壊防止板で固定すること。

1.8.4. 提出書類

- ① 鉛ブロックのミルシート
- ② 鉛ブロックを積み上げた状態での寸法検査結果

1.9. 可動マスク (MVX)

1.9.1. 概要

本装置は、可動マスク受光部、精密駆動ステージ、及びベローズパイプと支持台から構成される

(図 1-9(a))。可動マスク受光部により軸外の放射光部分をカットすることで、本装置の下流に設置される XY スリットの熱負荷を低減することを目的とする。受光部は、基本的には冷却水により冷却するが、システム全体として度重なる発熱・冷却によるサイクルに対して、その構造・性能を維持するものとする。精密駆動ステージは可動マスク受光部をビーム軸に直交する水平方向及び垂直方向に精密に駆動する。

1.9.2. 可動マスク受光部

本装置は放射パワーを除去するための主要部分である。可動マスクそれ自体が超高真空仕様の真空容器の一部となっている。放射パワーによる発熱は水冷却により処理する。

1.9.2.1. 仕様

- ① 全長：380L×95W×80H (参考値)。内面は超高真空仕様とすること。
- ② 材質等は GlidCop-AL15 (受光部)、Cu コイル、SUS304、SS とする。
- ③ 可動マスク受光部本体部の 材質は GlidCop AL-15 を使用し、ブロック材からの切断加工とすること。
- ④ 放射光を通過させる穴を 2 種類 (コミッシュヨニングモード、標準モード) 設置すること。
- ⑤ コミッシュヨニングモードは入口径 $\phi 16$ mm 程度、出口径 $\phi 11$ mm 程度 (いずれも参考値) とすること。標準モードは出口径 $\phi 4$ mm、その上流部は 170 mm 程度の斜入射受光のための約 1° のテーパ部を設けること (いずれも参考値)。出口径 $\phi 4$ mm 部の下流に 40 mm 程度のストレート部を設けること。入口径は $\phi 16.3$ mm 程度とすること (いずれも参考値)。コミッシュヨニングモードと標準モードのピッチは 28 mm 程度 (参考値) とすること。
- ⑥ 接続管(2 個)は SUS304 で製作し、超高真空仕様とすること。
- ⑦ フランジ(2 個)SUS304 製作し、ビーム軸取合フランジは ICF114/ICF114 とする。フランジ面間は 380mm 程度 (参考値) とすること。I
- ⑧ 水路は内径 10 mm とし、流路内には直径 1.5 mm でピッチ 10 mm、コイル外径 10 mm の銅線コイルをロウ付けにより取り付け、流路方向に沿って円周方向に一ヶ所固定すること。また、本固定が健全なものであることを工業用内視鏡等により確認すること。また、冷却水路は、図 1-9(b)を参考に複数本設け、それらが直列となるような構造とすること。出荷前に所定の圧力条件 ($\Delta P=0.5$ MPa) において所定の流量 (20 L/min 以上) が流れることを確認すること。水路の継手は金属製食い込み継手(Swagelok)を使用すること。冷却水入出部の短管と本体は EB 溶接で (ねじ込み式は不可) 接続すること。
- ⑨ ベーキング用ヒータとしてのプレートヒータ等を可動マスク受光部本体外面に取り付けること。ベーキング時の GlidCop の最大温度は 180°C とするが、ヒータ自身の能力としては 250°C までベーキング可能なようにしておくこと。
- ⑩ 温度センサーとして JIS-K タイプで外径 1.6 mm の非接地型シース熱電対 4 個 (参考値) をバヨネット型フィッティング等により本体に固定すること。機器近傍にて補償導線と専用コネクタ (オメガ熱電対コネクタ相当品) で接続させること。なお、端部には識別可能なタグを取り付けること。

- ① 水平方向のコミッショニングモード、標準モード、ビーム軸取合フランジそれぞれの中心を確認出来るよう視準用ピンを用意すること。視準用ピンは受光部上面の上流、下流 2カ所に取付可能なようにすること。視準用ピンの長さは 50 mm、70 mm の 2本用意すること。

1.9.2.2. 機器仕様

- ① 可動マスク本体のアライメント基準は、本体外面とすること（内面のビーム軸と本体外面が一致していること）。
- ② ビーム軸フランジの本体基準面に対する溶接精度は、 ± 0.2 mm 以下であること。
- ③ 受光部テーパ部全域において、テーパ角が規定値以上に逸脱しない加工を行うこと。
- ④ 本体外面に、ビーム軸と基準面との実測寸法、及びシリアル No. を刻印すること。
- ⑤ 本体上面光軸上に、レーザートラッカー用ターゲット（SMR）が搭載可能なターゲット穴（ $\phi 4/H7$ ）を 2箇所以上設けること。また、本体上面は、ローリングを測定するための高精度水準器が使える水平基準面であること。
- ⑥ 加工方法によって完成品では確認できない部位に対しては、事前にモックアップ試験を行い、承認を得ること（過去の実績提示でも可）。
- ⑦ 基準面となる本体外面が酸化・変色しないような梱包処置を行うこと（例えば、本体をビニール袋で 2重に被い、シリカゲル等を入れたあと N_2 で膨らませる等）。
- ⑧ 納入前に単体ベーキング（24 時間保持）を行い、所定の温度に上がることとリーク量が許容リーク量以下であることを確認すること。
- ⑨ 架台の柱には低熱伝導型スタット（図 1-7(d)）を使用すること。

1.9.2.3. 据付仕様

- ① 機器据付時：受光部の据付基準は本体外面とし、リングトンネル床面基準点に対して行うこと。受光部本体上下流の視準ピンによる仮想軸が、床面基準の光軸に対して水平・垂直とも平行（ピッチング及びヨーイングが ± 0.1 mm 以下；目標 ± 0.05 mm 以下）であること。
- ② QST が指定する時期にレーザートラッカーを用いた最終アライメントを実施すること。SMR の設置精度はトラッカー測量に基づいたビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下（目標 ± 0.1 mm 以下）であること。さらに、受光部本体上下流の SMR を結んだ仮想軸がトラッカー測量に基づいた光軸に対して水平・垂直とも平行（ピッチング及びヨーイングが ± 0.1 mm 以下；目標 ± 0.05 mm 以下）であること。
- ③ 冷却水母配管からの枝配管を行うこと。母配管との取合バルブサイズは 20A（3/4"）とすること。
- ④ 母配管からの枝配管は $\phi 16$ mm の BA 管（SUS304）を使用し、可動マスクには 20A の金属フレキホース配管を用いて接続すること。接続部は Swagelok を使用すること。また、作業前に配管系統図を提出して承認を得ること。
- ⑤ 冷却水路の OUT 側に現場表示及びアラーム接点付き流量計を設置すること。

1.9.3. 可動マスク用精密駆動ステージ

可動マスク受光部をビーム軸に直交する水平方向及び垂直方向に精密に駆動する。駆動におい

てはパルスモータを使用し、パルスモータコントローラー、ドライバを介してコンピュータで制御するものとする。また、リミットスイッチや原点読みだしの機能を有し、駆動量を表示する機能が必要である。超精密アライメント装置 XY 型（トヤマ製 0TA-00174-A 相当品）（図 1-10(d)）とする。

- ① X ステージ及び精密 Z ステージから構成され、パルスモータ（オリエンタルモータ製高トルク 5 相ステッピングモータ PK569H-B 相当品）により駆動すること。
- ② テージの性能としては、X ステージ：2 $\mu\text{m}/1$ パルス、Z ステージ：0.5 $\mu\text{m}/1$ パルス（高精度減速装置を利用）以下であること。
- ③ X、Z ステージの可動範囲は以下のとおりとする。但し、実際の可動範囲（リミットスイッチの設定）については別途協議する。

X ステージ	:	-20 ~ + 20 mm
Z ステージ	:	-15 ~ + 15 mm
- ④ 繰り返し位置決め精度は X、Z ステージとも $\pm 1 \mu\text{m}$ 以内であること。
- ⑤ ピッチング、ヨーイングは X、Z ステージそれぞれに対して 5 秒以内であること。
- ⑥ 真直度は X、Z ステージともフルストロークに対して 1 μm 以内であること。
- ⑦ 耐荷重は 80 kg 以上であること。
- ⑧ リミットスイッチを有し、ロジックは NC（ノーマルクローズ）とすること。
- ⑨ エンコーダ（オムロン製ロータリーエンコーダ、インクリメンタル形、ラインドライバ出力 E6B2-CWZ1X(2000 P/R)相当品）を使用し、駆動量を表示する機能を有すること。また、エンコーダ本体のみコンパクトに遮蔽できる保護シールドボックス付きであること。
- ⑩ センサー（マグネスケール製マグネスイッチ SET- K2 相当品）による原点読みだし機能を有し、当センサーによる原点検知により駆動パルスを停止させることが可能であること。繰り返し精度は X ステージに対しては $\pm 5 \mu\text{m}$ 以内、Z ステージに対しては $\pm 1 \mu\text{m}$ 以内であること。
- ⑪ X、Z 両ステージとも動きは完全に独立であり、他方の動きにより影響を受けないこと。
- ⑫ フロントエンド共通ビームに設置できる構造となっていること。
- ⑬ エンコーダ本体のみコンパクトに遮蔽できる専用の遮蔽 BOX を取り付けること。
- ⑭ リングトンネル内で用いるケーブルは耐放射線ケーブルとすること。
- ⑮ エンコーダケーブル、パルスモータ駆動ケーブルと取り合える中継ボックス（図 1-10(e)）を付属すること。

1.9.3.1. 機器仕様

- ① ビーム軸に対して、駆動系の原点をどの様に設定するかは財団担当者と協議のうえ決定すること。
- ② リミットスイッチ、原点センサーの設定については別途協議のうえ決定すること。
- ③ 繰り返し位置決め精度、ピッチング、ヨーイング、真直度は XY スリット受光部と組み合わせ、真空環境下で達成すること。また、これが不可能な場合には相当荷重の鉛等を載せた状態で達成すること。
- ④ ケーブル・コネクターの形式及びピンアサインは QST 担当者に確認すること。

1.9.3.2. 据付仕様

- ① 精密駆動部の据え付けはリングトンネル床面基準点に対して行うこと。
- ② 駆動部単体での設置精度は、ピッチング、ヨーイングについては 14 秒以内、ローリングについては水準器 (0.02 mm/m/目盛) で 1 目盛り以内とする。詳細は別途協議する。

1.9.4. 軸直角方向駆動用溶接ベローズ及び支持台

可動マスク受光部のビーム軸に対する軸直角変位を可能にする。支持台は ICF フランジあるいはフランジ付きニップルをフロントエンド共通ビームにしっかりと固定するものである。ベローズパイプ 2 台と、ベローズパイプ用支持台 2 台で構成される。

1.9.4.1. ベローズパイプ

- ① 溶接ベローズの自重によるたわみを極力抑えるため、ICF フランジ、接続管、溶接ベローズ、接続管、溶接ベローズ、接続管、ICF フランジといった構造とすること。(図 1-9(c))
- ② 両側のフランジは ICF70RH/ICF114FH とし、面間寸法は 260 mm (参考値) とすること。
- ③ 最大 250°C のベーキング対応であること。
- ④ ベローズ仕様
 - i. 圧力 : 内部→真空、外部→大気
 - ii. ベローズ内径 : $\phi 70$ mm
 - iii. 材質 : SUS304
 - iv. 姿勢 : 水平
 - v. 変位量 : 軸直角方向に ± 24.5 mm
 - vi. 寿命 : 10,000 回以上
 - vii. その他 : パイプ内面電解研磨処理

1.9.4.2. ベローズパイプ用支持台

- ① ベローズパイプに 1 台ずつ使用する。(図 1-9(c))
- ② フロントエンド共通ビームに設置できるような構造となっており、また支持架台の大きさは、可動マスクの上流側、下流側の機器の領域にかかるものではないこと。
- ③ フランジ又は ICF フランジ付ニップルを固定するもので、共通ビームの設置基準面から光軸までの距離 (水平 120 mm、垂直 300 mm) を考慮すること。
- ④ 駆動系の最大変位や、超高真空による如何なる影響も受けないようなしっかりした構造であること。

1.9.5. 工場出荷前試験

① 外観・寸法試験

外観 (特に真空内面) に有害な傷、変形、シミ・汚れ等のないことを確認すること。また納入仕様書に指示された主要寸法及び公差とおりにあることを確認すること。(特にダブルスリット部)。

② ヘリウムリーク試験

ベーキング前後においてリーク量が 1×10^{-11} Pa·m³/sec 以下であることを確認すること。

③ 冷却水路耐圧・漏洩試験

N₂ ガス 1 MPa·G で加圧し、スヌープ等で漏れがないこと及び 30 分間放置して顕著な漏れ (-0.1 MPa·G) がないことを確認すること。水を用いた同等の検査でも可とする。詳細は打ち合わせのうえ決定する。

④ 冷却水通水試験

所定の圧力条件 (機器の出入口での $\Delta P = 0.5$ MPa) において、所定の流量が (20 L/min 以上) 流れることを確認すること。また、水温も記録すること。

⑤ 動作試験

駆動部の動作試験を行うこと。

⑥ ベーキング用ヒータ通電試験

ベーキング用ヒータに通電を行い、ヒータ線と受光部が絶縁されていること、受光部が均一に昇温できることを確認する。なお、ベーキング時には冷却水路の真空排気を行った状態で実施すること。

⑦ 熱サイクル試験

受光部本体をベーキング用ヒータにより 150℃まで昇温させ、30 分保持後 50℃まで自然冷却させる作業を 3 回繰り返し、その後上記 ②項に記載のヘリウムリーク試験を行うこと。

⑧ 受光部テーパ角度計測試験

受光部のテーパ角度が既定値以内であることを確認すること。

1.9.6. 内周通路側制御部設置機器

- ① ステッピングモータドライバ (メレック製 H-584/AD5610 1 軸ユニット相当品) : 2 台
- ② ステッピングモータ制御装置 (ツジ電子製 PM16C-04XDL 相当品) : 1 台 (共用可)
- ③ エンコーダ表示器 (ツジ電子製 ER4C-04 相当品) : 1 台

1.9.7. 内周通路側制御部への配線

- ① 水流量接点 (F E 主制御ラックへ) : 1 本
- ② 補償導線 (F E 主制御ラックへ) : 4 本
- ③ パルスモータ駆動ケーブル (ドライバ、コントローラへ) : 2 本
- ④ ロータリエンコーダケーブル (エンコーダカウンタへ) : 2 本

1.10. XY スリット HX 型

1.10.1. 概要

本装置は、XY スリット受光部、精密駆動ステージ及びベローズパイプと支持台から構成される

(図 1-10(a))。スリット受光部によりビーム利用実験に使用されない放射光部分をカットすることで、本装置より下流に設置される光学素子等の熱負荷を低減することを目的とする。受光部は、基本的には冷却水により冷却するが、システム全体として度重なる発熱・冷却によるサイクルに対して、その構造・性能を維持も担う。精密駆動ステージはXYスリット受光部をビーム軸に直交する水平方向及び垂直方向に精密に駆動する。(図 1-10(a)～(d))

1.10.2. 構成

1.10.2.1. XY スリット受光部

本装置は放射パワーを除去するための主要部分である。L型スリット u (1 個)、L型スリット d (1 個)から構成され、L型スリット自体が超高真空仕様の真空容器の一部となっている。放射パワーによる発熱は水冷却により処理する。(図 1-10(a)～(c))

1.10.2.1.1. 構成

(a) L型スリット u、L型スリット d (図 1-10(b), (c))

- ① ビーム軸両端フランジは ICF114 とし、接続管・フランジを含めた面間寸法はいずれも 530 mm (参考値) とする。従って、下記の軸直角方向駆動用溶接ベローズを含めた全長では 1860 mm (参考値) となる。
- ② 材質は無酸素銅 (OFHC/C1011) を使用し、ブロック材からの切削加工とすること。
- ③ 真空内面は超高真空仕様とすること。
- ④ 斜入射受光のための傾斜角は 1/50 程度 (参考値) とするが、詳細は別途協議のうえ、受光部の処理可能な最大熱量の設計により最終的に決定すること。
- ⑤ L型スリットのエッジ部分にはナイフエッジを採用し、スリットより下流への散乱光を極力減らすような構造とすること。
- ⑥ L型スリットエッジ部の熱変形によるビーム成形への影響を極力抑えるよう、また透過成分によるビーム端部のぼやけを小さくするようにヘビーメタル (タンタル) によりダブルスリットを構成すること。
- ⑦ ヘビーメタルの受光面も斜入射構造とすること。傾斜角については、別途協議のうえ、ヘビーメタルの処理可能な最大熱量の設計により最終的に決定すること。

(b) 接続管、フランジ

- ① SUS304 で製作し、超高真空仕様とすること。
- ② ICF114 フランジを用いること。
- ③ 1 ビームラインあたり接続管、フランジはそれぞれ 4 個用いること。

(c) ダブルスリット

- ① ダブルスリットはL型スリット u、L型スリット d に各それぞれ 1 個用いること。
- ② ダブルスリット部のヘビーメタルの取り付け精度 (直入射部分が 50～100 μm 程度) については別途協議する。ダブルスリットと OFHC/C1011 との間には熱接触向上のため銀箔などのシムを挟むこと。また、取り付けに用いるビス等にはガス抜き処理を施し、ゆるみ防止のために皿バネやスプリング・ワッシャーなどを用いること。

- ③ ダブルスリット部のヘビーメタルブレードの隅角部は R0.05 mm 以下であること。計測結果及び写真を試験検査成績書に添付すること。

(d) 冷却水流路

- ① 冷却チャンネルは内径 10 mm とし、5 本程度のチャンネルを設けること（図 1-9(c) 参照）。
- ② 複数の冷却チャンネルが直列となるように加工すること。
- ③ 冷却水入出部は金属製食い込み継手(Swagelok)を使用すること。
- ④ 冷却水入出部の短管と本体は EB 溶接（ねじ込み式は不可）で接続すること。

(e) ヒータ

- ① ベーキング用のプレートヒータ等を受光部本体外面に取り付けること。
- ② ベーキング時の無酸素銅の最高温度は 150℃以下とするが、ヒータ自身の能力としては 200℃までベーキング可能なようにしておくこと。

(f) 温度センサー

- ① 温度センサーとし、JIS-K タイプで外径 1.6 mm の非接地型シース熱電対 2 個（L 型スリット u、L 型スリット d に各 1 個；参考値）をバヨネット型フィッティング等により本体に固定すること。
- ② 機器近傍にて補償導線と専用コネクタ（オメガ熱電対コネクタ相当品）で接続させること。なお、端部には識別可能なタグを取り付けること。

1.10.2.1.2. 仕様

- ① 斜入射受光型の L 型スリットを基本型とすること。
- ② L 型スリットと接続管の接合については別途協議すること。取付精度はビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下とする。
- ③ 接続管とフランジの間の接合には Tig 溶接又は EB 溶接を採用し、内側溶接を施すこと。溶接の取付精度はビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下とする。
- ④ XY スリット受光部は第 1.10.2.2 項に記載の精密駆動ステージの上に設置する。如何なる場合にも、この精密駆動ステージにダメージを与えるような熱が伝わらないような取付方法を採用すること。必要に応じて低熱伝導型スタット（図 1-7(d)）を用いること。
- ⑤ XY スリット受光部を精密駆動ステージとともに フロントエンド共通ビームに設置した際、基準面から光軸までの高さ 300 mm（参考値）に受光部基準点がかかるような形状を満たすものとする。L 型スリットの外壁には、受光部基準点を確認できるようなケガキ線を入れること。なお、この受光部基準点の設定は QST 担当者と協議すること。また、 ± 5 mm 程度の範囲で高さ調整が出来るような構造でなければならない。
- ⑥ 納入前に、スリット本体で単体ベーキング（24 時間保持）を行い、所定の温度に上がることとリーク量が許容リーク量以下であることを確認すること。詳細は協議のうえ決定する。
- ⑦ スリット本体のアライメント基準面は L 型スリット u、d 本体外面とする（内面のビーム軸と本体外面が一致していること。）こと。
- ⑧ 電磁弁及びリミットスイッチ等の部品の選定には耐放射線性を考慮し、日本において容易に入手可能なものであること。
- ⑨ 受光部テーパ部全域において、テーパ角が規定値以上に逸脱しない加工を行うこと。

- ⑩ 本体外面に、ビーム軸と基準面との実測寸法及びシリアル No. を刻印すること。
- ⑪ 本体上面光軸上に、SMR が搭載可能なターゲット穴 ($\phi 4/H7$) を 2 箇所以上設けること。また、本体上面は、ローリングを測定するための高精度水準器が使える水平基準面であること。
- ⑫ 加工方法によって完成品では確認できない部位に対しては、事前にモックアップ試験を行い、QST 担当者の承認を得ること（過去の実績提示でも可）。
- ⑬ 基準面となる本体外面が酸化・変色しないような梱包処置を行うこと（例えば、本体をビニール袋で 2 重に被い、シリカゲル等を入れたあと N_2 で膨らませる等）。
- ⑭ 納入前に単体ベーキング（24 時間保持）を行い、所定の温度に上がることとリーク量が許容リーク量以下であることを確認すること。

1.10.2.1.3. 据付

- ① スリット本体の据付基準は L 型スリット u, d 本体外面とし、リングトンネル床面基準点に対して行うこと。
- ② スリット本体の設置精度（ピッチング・ヨーイング・ローリング）についてはダブルスリットの機能を損なわないものとする。詳細は協議のうえ決定する。
- ③ 設置作業終了後、スリット本体上流端、下流端における本体基準面のレール基準面からの寸法及び計測位置を水平・垂直方向について提出すること。
- ④ 最終アライメントは QST が行う測量に基づき実施すること。SMR の設置精度はトラッカ測量に基づいたビーム軸に対して $\pm 0.2\text{mm}$ 以下（目標 $\pm 0.1\text{mm}$ 以下）であること。さらに、各 L 型スリット (u, d) において、上下流の SMR を結んだ仮想軸がトラッカ測量に基づいた光軸に対して水平・垂直とも平行（ピッチング及びヨーイングが $\pm 0.04\text{mm}$ 以下；目標 $\pm 0.02\text{mm}$ 以下）であること。
- ⑤ 冷却水母配管からの枝配管を行うこと。母配管との取合バルブサイズは 15A (1/2") とすること。
- ⑥ 母配管からの枝配管は $\phi 12\text{mm}$ の BA 管 (SUS304) を使用し、XY スリット本体には 15A の金属フレキホース配管を用いて接続すること。接続部は金属製食い込み継手 (Swagelok) を使用すること。また、作業前に配管系統図を提出して承認を得ること。
- ⑦ 冷却水路の OUT 側に現場指示及びアラーム接点付き流量計を、L 型スリット u、L 型スリット d に各 1 台設置すること。

1.10.2.2. XY スリット用精密駆動ステージ

XY スリット受光部をビーム軸に直交する水平方向及び垂直方向に精密に駆動する。駆動においてはパルスモータを使用し、パルスモータコントローラ、ドライバを介してコンピュータで制御するものとする。また、リミットスイッチや原点読みだしの機能及び、駆動量を表示する機能を有すること。

1.10.2.2.1. 構成

- ① 超精密アライメント装置 XY 型（トヤマ製 0TA-00174-A 相当品）（図 1-9(d)）を L 型スリット u 及び L 型スリット d にそれぞれ 1 台用いる。
- ② 超精密アライメント装置 XY 型は X ステージおよび精密 Z ステージから構成すること。パル

スモータ（オリエンタルモータ製高トルク 5 相ステッピングモータ PK569H-B 相当品）により駆動すること。

- ③ ステージの性能としては、Xステージ：2 $\mu\text{m}/1$ パルス、Zステージ：0.5 $\mu\text{m}/1$ パルス（高精度減速装置を利用）以下であること。
- ④ X、Zステージの可動範囲は以下のとおりとする。但し、実際の可動範囲（リミットスイッチの設定）については別途協議する。
 - Xステージ : -20 ~ +20 mm
 - Zステージ : -15 ~ +15 mm
- ⑤ 繰り返し位置決め精度はX、Zステージとも $\pm 1\mu\text{m}$ 以内であること。
- ⑥ バックラッシュはX、Zステージとも $2\mu\text{m}$ 以内であること。
- ⑦ ピッチング、ヨーイングはX、Zステージそれぞれに対して 5 秒以内であること。
- ⑧ 真直度はX、Zステージともフルストロークに対して 1 μm 以内であること。
- ⑨ 耐荷重は 80 kg 以上であること。
- ⑩ リミットスイッチを有し、ロジックはNC（ノーマルクローズ）とすること。
- ⑪ エンコーダ（オムロン製ロータリーエンコーダ、インクリメンタル形、ラインドライバ出力 E6B2-CWZ1X(2000 P/R)相当品）を使用し、駆動量を表示する機能を有すること。また、エンコーダ本体のみコンパクトに遮蔽できる保護シールドボックス付きであること。
- ⑫ 位置センサー（マグネスケール製マグネスイッチ SET- K2 相当品）による原点読みだし機能を有し、当センサーによる原点検知により駆動パルスを停止させることが可能であること。繰り返し精度はXステージに対しては $\pm 5\mu\text{m}$ 以内、Zステージに対しては $\pm 1\mu\text{m}$ 以内であること。
- ⑬ X、Z両ステージとも動きは完全に独立であり、他方の動きにより影響を受けないこと。
- ⑭ フロントエンド共通ビームに設置できる構造となっていること。
- ⑮ エンコーダ本体のみコンパクトに遮蔽できる専用の遮蔽 BOX を取り付けること。
- ⑯ リングトンネル内で用いるケーブルは耐放射線ケーブルとすること。
- ⑰ エンコーダケーブル、パルスモータ駆動ケーブルと取り合える中継ボックス（図 1-9(e)）を付属すること。

1.10.2.2.2. 仕様

- ① ビーム軸に対して、駆動系の原点をどの様に設定するかは QST 担当者と協議のうえ決定すること。
- ② リミットスイッチ、原点センサーの設定については別途協議のうえ決定すること。
- ③ 繰り返し位置決め精度、ピッチング、ヨーイング、真直度はXYスリット受光部と組み合わせ、真空環境下で達成すること。また、これが不可能な場合には相当荷重の鉛等を載せた状態で達成すること。
- ④ ケーブル・コネクタの形式及びピンアサインは QST 担当者に確認すること。

1.10.2.2.3. 据付

- ① 精密駆動部の据え付けはリングトンネル床面基準点に対して行うこと。
- ② 駆動部単体での設置精度は、ピッチング、ヨーイングについては 14 秒以内、ローリングに

については水準器 (0.02 mm/m/目盛) で 1 目盛り以内とする。詳細は別途協議する。

1.10.2.3. 軸直角方向駆動用溶接ベローズ及び支持台

XY スリット受光部真空槽のビーム軸に対する軸直角変位を可能にする。支持台は ICF フランジあるいはフランジ付きニップルをフロントエンド共通架台に堅牢に固定するものである。

1.10.2.3.1. 構成

(a) 溶接ベローズタイプ 1

- ① 1 ビームラインあたり 2 台とする。(図 1-9(f))。
- ② 溶接ベローズの自重によるたわみを極力抑えるため、ICF フランジ、接続管、溶接ベローズ、接続管、溶接ベローズ、接続管、ICF フランジといった構造とする。
- ③ 溶接ベローズの長さは、XY スリットで最大 15 mm 程度の軸直角変位を可能とするよう製作すること。
- ④ 両側のフランジは ICF70RH/ICF114FH とし、面間寸法は 220 mm (参考値) とする。

(b) 溶接ベローズタイプ 2

- ① ビームラインあたり 1 台とする。(図 1-9(g))
- ② 溶接ベローズの自重によるたわみを極力抑えるため、ICF フランジ、接続管、溶接ベローズ、接続管、溶接ベローズ、接続管、ICF フランジといった構造とする。
- ③ 溶接ベローズの長さは、XY スリットで最大 15 mm 程度の軸直角変位を可能とするよう調整すること。
- ④ 両側のフランジは ICF114RH/ICF114FH とし、面間寸法は 360 mm (参考値) とする。

(c) 支持台

- ① ビームラインあたり 3 台とする。(図 1-9(h)、(i))
- ② 共通ビーム支持架台に設置できるような構造となっており、また支持架台の大きさは、XY スリットの上流側、下流側の機器の領域にかかるものではないこと。
- ③ フランジ又は ICF フランジ付ニップルを固定するもので、共通架台の設置基準面から光軸までの高さ 300 mm を考慮すること。
- ④ 駆動系の最大変位や、超高真空による如何なる影響も受けないような堅牢な構造であること。

1.10.3. 工場出荷前試験

工場出荷前に下記試験等を行うこと。詳細は別途協議する。

① 外観・寸法試験

外観 (特に真空内面) に有害な傷、変形、シミ・汚れ等のないことを確認すること。また納入仕様書に指示された主要寸法及び公差とおりであることを確認すること。(特にダブルスリット部)。

② ヘリウムリーク試験

ベーキング前後においてリーク量が 1×10^{-11} Pa \cdot m³/sec 以下であることを確認すること。

③ 冷却水路耐圧・漏洩試験

N₂ ガス 1 MPa \cdot G で加圧し、スヌープ等で漏れが無いこと及び 30 分間放置して顕著な漏れ (-

0.1 MPa・G) が無いことを確認すること。水を用いた同等の検査でも可とする。詳細は打ち合わせのうえ決定する。

④ 冷却水通水試験

所定の圧力条件 (機器の出入口での $\Delta P=0.5$ MPa) において、所定の流量が (10 L/min 以上) 流れることを確認すること。また、水温も記録すること。

⑤ 動作試験

駆動部の動作試験を行うこと。

⑥ ベーキング用ヒータ通電試験

ベーキング用ヒータに通電を行い、ヒータ線と受光部が絶縁されていること、受光部が均一に昇温できることを確認する。なお、ベーキング時には冷却水路の真空排気を行った状態で実施すること。また、熱サイクル試験受光部本体をベーキング用ヒータにより 150℃まで昇温させ、30 分保持後 50℃まで自然冷却させる作業を 3 回繰り返す、その後上記 (b) に記載のヘリウムリーク試験を行うこと。

⑦ 受光部テーパ角度計測試験

受光部のテーパ角度が既定値以内であることを確認すること。

1.10.4. 内周通路側制御部設置機器

- | | |
|---|-------|
| ① ステッピングモータドライバ (メレック製 H-584/AD5610 1 軸ユニット相当品) | : 4 台 |
| ② ステッピングモータ制御装置 (ツジ電子製 PM16C-16EC2 相当品) | : 1 台 |
| ③ エンコーダ表示器 (ツジ電子製 ER4C-04A 相当品) | : 1 台 |
| ④ XY スリット開口制限ユニット (ツジ電子製 T3956-02 相当品) | : 1 台 |

1.10.5. 内周通路側制御部への通線

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ① 水流量接点 (FE 主制御ラックへ) | : 1 本 |
| ② 補償導線 (FE 主制御ラックへ) | : 2 本 |
| ③ パルスモータ駆動ケーブル (ドライバ、コントローラへ) | : 4 本 |
| ④ ロータリーエンコーダケーブル (エンコーダカウンタへ) | : 4 本 |

1.11. ビームシャッター(BS)

1.11.1. 概要

必要に応じてタングステンブロックを光軸上に下ろすことにより実験ホール内に放射線が漏洩しないようにする。(図 1-11(a))

1.11.2.構成

- ① 真空チェンバ本体の寸法を 400L×300W×750H (参考値)、遮蔽体 (タングステン) の寸法を 300L×70W×60H (プラス公差であること) とする。
- ② 遮蔽体の材質はタングステン (日本タングステン社製ヘビーアロイ HAC1 相当品であること。相当品を使用する場合には、製作前に真空特性試験を行い QST 担当者の承認を得ること)、他は SUS304、SS、とする。
- ③ タングステンブロックの駆動に エアシリンダを用いること。
- ④ ベローズは、材質 AM350、変位量 50 mm 以上、耐用回数(寿命)100,000 回以上、耐熱温度 250°C とする。

1.11.3.仕様

- ① シャッターの開状態と閉状態を検出するために 2 連高耐久型リミットスイッチを 2 組設置すること。各リミットスイッチの信号は独立 (パラ) に、1 つのコネクタを介した多芯ケーブルで取り出すこと。
- ② 加速器安全インターロックシステムに出力するための閉状態信号用として、上記①項に記載のもの以外に、閉側に高耐久型リミットスイッチを 1 組設置すること。
- ③ 真空配管の熱膨張を吸収できるよう可動型台座 (図 1-11(b)) を採用すること。
- ④ ビーム軸フランジの溶接取り付け精度はチェンバ軸に対して±0.2 mm 以下であること。
- ⑤ シャッター閉状態の遮蔽体軸精度はチェンバ軸に対して±0.2mm 以下であること。
- ⑥ 遮蔽体はタングステンの含有量が 95.0%以上であり、実寸法は 300.0L×70.0W×60.0H 以上 (プラス公差) であること。
- ⑦ FE/PLC 制御盤からの動作指令によるステータス状況を返信できるダミーリレーを 1 個付属品として納入すること。
- ⑧ 開閉の動作時間が 8~9 秒程度で調整できる構造であること。

1.11.4.工場での組立・調整

- ① チェンバ及び遮蔽体を別々に単独で高温ベーキングを行い、圧力に異常がないことを確認すること。
- ② 次にチェンバの中に遮蔽体を入れた状態でベーキングを行い、圧力に異常がないことを確認すること。また、質量分析計によるマス分析を行い、異常がないことを確認すること。
- ③ 輸送時に機器の性能を損なわない荷姿とすること。必要に応じて、遮蔽体を再度チェンバから取り外し別々に梱包・出荷・輸送すること。なお、チェンバは真空引きを行い、真空封止の状態での納入すること。真空封止部にはガス導入バルブを使用し、ベント時に操作し易い構造とすること。

1.11.5. 現地での組立・調整及び据付仕様

- ① アライメント基準はビーム軸フランジ中心とすること。
- ② ビーム軸フランジの設置精度はレール基準のビーム軸に対し ± 0.2 mm 以下であること。
- ③ 圧空母配管からの枝配管を行うこと。
- ④ 圧空枝配管には逆流防止弁と、リザーバータンク (3 L) を設置すること。
- ⑤ リザーバータンクの機器取合配管部は、クイックカップラ取り合いとすること。
- ⑥ 開閉の動作時間を 8~9 秒で調整すること。

1.11.6. 内周通路側制御部への通線

- ① エアシリンダ駆動用及びリミットスイッチ用ケーブル (FE 主制御ラックへ) : 1 本
- ② 安全系リミットスイッチ用ケーブル(最大 100 m 程度)
(FE 主制御ラックを經由して加速器安全インターロック側端子台へ) : 1 本

1.11.7. 提出書類

- ① タングステンブロックのミルシート
- ② タングステンブロックの寸法試験結果

1.12. ゲートバルブ

1.12.1. 概要

フロントエンド真空系を分割することによってフロントエンド保守を容易にする。計 4 台とする。放射線環境下で使用するので全金属製とする。

1.12.2. 構成(一台あたり)

- ① オールメタルゲートバルブ (VAT 製 48232-CE44 相当品) : 4 台
- ② バネ支持台 (図 1-12(a)) : 4 個

1.12.3. 仕様

- ① 厳しい放射線環境下で使用するため、シール部 (ボンネット、ゲート) は全て金属製であること。
- ② 圧空作動式であり、複動シリンダ、開閉リミットスイッチ付き、DC24V 電磁弁付きであること。
- ③ コモンコネクタ (VAT 製 S48/DN40 用「243895」) を準備し電磁弁/本体間に配線すること。
- ④ バルブボディの耐熱温度は 300°C (延長アクチュエータ型) であること。

- ⑤ シール面の変形は弾性変形の範囲内であること。
- ⑥ 閉位置で機械的ロックがかかる構造であること。
- ⑦ バルブボディ、バルブシートのリーク量は 1×10^{-11} Pa·m³/sec 以下であること。
- ⑧ サイズは ICF70 (DN40)、面間距離は 72 mm、開口サイズは $\phi 40$ mm 以上であること。
- ⑨ アクチュエータの動作電圧は DC24V であること。
- ⑩ FE/PLC からの動作指令によるステータス状況を返信できるダミーリレーを 1 個付属品として納入すること。

1.12.4. 据付

- ① 共通レールへの据付に際しては、バネ支持台 (図 1-11(a)) で支持すること。
- ② GV1 は、端部排気真空槽用架台から支持すること。
- ③ 圧空母配管から枝配管を行うこと。

1.12.5. 内周通路側制御部への通線

ゲートバルブ駆動用ケーブル (FE 主制御ラックへ) : 1 本

1.13. シールド壁貫通管

1.13.1. 概要

リングトンネルと実験ホールを仕切るシールド壁を突き抜けて放射光を取り出すための真空配管である。(図 1-13(a))

1.13.2. 構成

- ① シールド壁貫通管 : 1 個及びシールド材 (鉛) : 1 式からなる。
- ② 材質は SUS304、鉛 とする。また、ベーキングヒータを装備する。

1.13.3. 仕様

- ① 融点の低い鉛シールドブロックがこの配管を取り囲むため、ベーキングヒータを配管外壁に埋め込むことによって鉛の熔融を避けるような構造とすること。
- ② 配管のベーキング温度を測定するためにあらかじめ熱電対 (K タイプ) を 4 本程度取り付けられるようにして置くこと。
- ③ ビーム軸フランジの溶接取り付け精度はチェンバ軸に対して ± 0.2 mm 以下であること。
- ④ 配管長尺方向の真直度は ± 0.2 mm 以下であること。
- ⑤ ビーム軸フランジと本体チェンバ部との溶接はネック部で行うこと。

1.13.4. 据付

- ① ビーム軸フランジの設置精度は床面基準点に基づいたビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下（目標 ± 0.1 mm 以下）であること。
- ② 本器を設置後、シールド壁穴と本器との間に鉛ブロックを多層に分けて隙間なく詰めること。鉛ブロックのビーム軸方向の長さは、リングトンネル側に開けられている 400 mm 角の開口 A（ライン図(図 A)参照）の全域とする。必要に応じて鉛毛を使用すること。作業前に 1 層毎の鉛ブロック配列図を提出し、QST 担当者の承認を得ること。詳細は別途指示する。
- ③ 本器設置後のシールド壁穴部の埋め戻し作業については、1 層設置ごとにカラー写真撮影を行い提出すること。撮影時には曲尺をあてて、ラチェット面からの寸法が分かるようにすること。
- ④ 蓄積リング運転時かつビームシャッター閉時において、実験ホール側への放射線漏洩が安全基準を超えた場合、安全基準以下になるよう迅速に壁穴の遮蔽補強を行うこと。
- ⑤ 本機器を遮蔽壁（壁内、壁外の両側）に固定する支持部を準備すること。

1.13.5. 提出書類

- ① シールド壁穴部の鉛埋め戻し時の 1 層毎のカラー写真
- ② 1.13.4 ②項に記載の鉛ブロック配列図
- ③ 鉛ブロックのミルシート

1.14. 光電子モニター(IOM)

1.14.1. 概要

光電子モニター (IOM) は、XY スリット受光部等の駆動可能な高熱負荷機器を、光軸に対して軸調整する時に使用されるもので、実験ホール光学ハッチ内に設置される。光電子モニターの挿入は圧空駆動で行う。(図 1-14(a))

1.14.2. 構成

- ① IOM 本体および専用真空チャンバからなる。
- ② IOM 駆動用エアシリンダを有する。
- ③ 材質は SUS304、SS、金箔とする。

1.14.3. 仕様

- ① 受光部には厚さ $50\ \mu\text{m}$ 程度の金箔を使用し、光電子放出による光電流が測定出来るようになっていること。ビームサイズは $\phi 18$ mm までとする。また、金箔を絶縁するための絶縁材と

して、厚さ 1 mm 以下の窒化アルミ等を使用し、金箔の両側に挟むこと。

- ② IOM を設置するための真空チャンバとして、面間 200 mm の ICF70 六方クロス等を準備すること。当真空チャンバは、放射光の出入口用ポート、IOM 設置用ポート、モニター部の状態監視用ポート、サービスポートを有すること。なお、状態監視用ポートには $\phi 70$ ICF 付サファイアビューイングポートを、サービスポートにはブランクフランジを取り付けること。
- ③ IOM と下流側に接続されるゲートバルブ (GV4) をサポートするための架台部 (水平・垂直方向の位置調整機能付き) を遮蔽壁又は床面から設けること。なお、GV4 の下流側にはブランクフランジを取り付けること。
- ④ 開閉駆動部は 40 mm 以上のストロークを備え、溶接ベローズ及びスピード制御付圧空シリンダ方式を採用し、動作時間を 2 秒程度に調整できる構造であること。
- ⑤ 水冷配管には 6 mm 銅パイプを採用し、継手は金属製食い込み継手 (Swagelok) とすること。
- ⑥ 信号線として、専用同軸ケーブル (参考値:20 m) を用意すること。コネクタは BNC-SHV とする。

1.14.4. 据付

- ① 出荷前にビーム軸フランジ基準に対して、モニター中心が ± 0.2 mm 以下になるように調整すること。
- ② ビーム軸フランジの設置精度はビーム軸に対して ± 0.2 mm 以下であること。
- ③ 圧空母配管から枝配管を行うこと。
- ④ 開閉の動作時間を 2 秒程度で調整すること。
- ⑤ リングトンネル内の冷却水ヘッダーから地下ピットを通して枝配管を行うこと。

1.14.5. 内周通路側制御部への通線

- | | |
|--|-------|
| ① エアシリンダ駆動及びリミットスイッチ用ケーブル (FE 主制御ラックへ) | : 1 本 |
| ② 水流量接点 (FE 主制御ラックへ) | : 1 本 |
| ③ 専用同軸ケーブル (FE 主制御ラック近傍へ) | : 1 本 |

1.15. 真空ベローズ

1.15.1. 概要

各真空装置部を連結するとともに、ベークアウト時の熱膨張を吸収する。(図 1-15(a)、(b)) なお、BS 下流ベローズは BS 下流に設置し、シールド壁貫通管と接続する。

種類、数量 (参考値)

- | | |
|---|--------|
| ① TYPE1 (ICF114/ICF70、面間 150 mm:参考値) | : 1 個 |
| ② TYPE2 (ICF70/ICF70、面間 130 mm:参考値) | : 10 個 |
| ③ BS 下流ベローズ (ICF70/ICF70、面間 280 mm:参考値) | : 1 個 |

1.15.2.仕様

ベローズ部は下記仕様を満たすこと。

- ① 用途 : 可動部の真空密封用 (超高真空対応であること)
- ② 圧力 : (内) 真空、(外) 大気
- ③ 温度 : ベーキング時最大 250℃
- ④ 変位量 : ±10 mm (BS 下流ベローズは±15 mm)
- ⑤ 使用回数 : 10,000 回以上
- ⑥ 流体 : Air
- ⑦ 材質 : SUS304 以上
- ⑧ リーク量 : 1×10^{-11} Pa·m³/sec 以下
- ⑨ フランジ : 片側固定、片側回転

1.16. ニップル

1.16.1.概要

各真空装置部を連結する。

1.16.2.仕様

- ① 材質は SUS304 とする。
- ② 必要に応じて ICF70 フランジ付きニップル (φ38×φ35) を面間調整用に使用すること。
- ③ ニップル内面は超高真空対応の処理 (バフ研磨後電解研磨処理) を行うこと。
- ④ 異径のフランジをもつ機器の接続には、必要に応じて変換フランジや変換ニップルを使用すること。
- ⑤ 設置現場の状況によっては必要個数が参考値を上回る可能性があることに注意すること。
- ⑥ パイプ支持架台 (図 1-16(a)、(b)) で、ニップルを共通ビームに固定すること。

1.17. フロントエンド真空装置仕様

フロントエンドの各真空装置は原則として以下の共通仕様を満足しなければならない。

- ① リーク量は 1×10^{-11} Pa·m³/sec 以下であること。
- ② アルミホイルを被せた状態で 250℃のベークアウト温度が達成できるようなヒータを取り付けること。ヒータは原則としてプレートヒータやシースヒータを採用すること。当該ヒータが装備できない機器に対してはリボンヒータ、ラバーヒータ等を準備すること。なお、各ヒ

ータはクランプメータによる計測が容易に行える形状であること。

- ③ 共通ビーム(第2章参照)に搭載される真空機器は、共通ビームを用いたアライメントに適合した専用架台(共通レール対応架台)を有していること。ただし、各真空機器の共通レール対応架台は、複数の共通レールに跨らないこと。
- ④ 真空フランジの溶接による取り付け誤差は特に指定なきものについて ± 0.5 mmとする。
- ⑤ タップ穴、ボルト穴の加工誤差は ± 0.2 mmとする。ただし、真空フランジについてはJIS規格に従うこと。
- ⑥ SS製ベース板上に真空装置を支持している場合は、低熱伝導型支柱(図(C)-03)を採用すること。
- ⑦ 超高真空部分と水冷却部分との間に溶接等の接合部が存在しないこと。また、冷却水路と本体部とのクリアランスは5 mm以上設けること。
- ⑧ 各真空装置部にはその軸芯を示すケガキ線をいれること。
- ⑨ 超高真空機器の組立・運搬の際は、真空又は乾燥した環境下に保持されなければならない。銅製部品の含まれる機器については、特に注意すること。
- ⑩ 真空チェンバ内面は超高真空対応の処理(電解研磨処理、洗浄、清浄度管理)を施すこと。
- ⑪ 真空計のゲージポートのコネクタ取合い部は、ケーブルの曲げ弾性等による負荷がかからないような構造・ケーブル配線とすること。
- ⑫ 電磁弁及びリミットスイッチ等の部品の選定には耐放射線性を考慮し、日本において容易に入手可能なものであること。

2. 共通ビームおよび架台

各真空装置は2本のH型共通ビーム上に設置され、しかるべき位置調整を実施することでビーム軸に対して基準水平面、垂直面を得られるようにする。これにより、あらかじめ軸調整を行った真空装置をこの共通ビームに取り付けるだけでビーム軸に対する精度は自動的に満足されるようにする。また、支持架台はこのビームを支持するものである。

- ① ビーム架台にはJIS規格のタップ穴加工を施すこと。
- ② 支持架台の塗装色は、マンセル 10YR7.5/13 とすること。

2.1. 共通ビーム支持架台

2.1.1. 概要

各真空装置は2本のH型共通ビーム上に設置されるが、本器はこれらの共通ビームを精度よく支持するためのものである。そのために本器上部にはビーム軸に対して基準水平面となるような小テーブルを設置する。この小テーブルには共通ビームを水平方向に微動できる機能を持たせる。(図2(a))ビームライン1本につき4台用意すること。

2.1.2. 据付

- ① リングトンネルにおけるビーム軸の床面からの高さの設計値は 1200 mm であるが、本器の製作においては若干の誤差を考慮し、スペーサー等で対処する必要がある。スペーサーの厚み等については別途協議して決定する。
- ② 床面の配管、配線、ピット穴及び基準点を避けて設置すること。また、鉛コリメータ専用架台との干渉も考慮すること。
- ③ 床面にアンカーで固定すること。

2.2. 共通ビーム支持架台簡易型

2.2.1. 概要

共通ビーム支持架台の簡易型である。補助的な支持に用いる。本器上部にもビーム軸に対して基準水平面となるような小テーブルを設置する。この小テーブルにも共通ビームを水平方向に微動できる機能を持たせる。(図 2(b))ビームライン 1 本につき 1 台用意すること。

2.2.2. 据付

- ① リングトンネルにおけるビーム軸の床面からの高さの設計値は 1200 mm であるが、本器の製作においては若干の誤差を考慮し、スペーサー等で対処する必要がある。スペーサーの厚み等については別途協議して決定する。
- ② 床面の配管、配線、ピット穴及び基準点を避けて設置すること。
- ③ 床面にアンカーで固定すること。

2.3. 壁外ビーム架台

2.3.1. 概要

シールド壁外側で共通ビームを支持する支持架台である。本器上部にもビーム軸に対して基準水平面となるような小テーブルを設置する。この小テーブルにも共通ビームを水平方向に微動できる機能を持たせる。(図 2(c))。ビームライン 1 本につき 1 台用意すること。

2.3.2. 据付

- ① 壁外ビーム架台は実験ホールの壁に固定し床に接しないこと。
- ② 実験ホールの床は蓄積リングトンネルの床より 200mm 低い。共通ビームは水平面、垂直面は蓄積リングトンネル内共通ビームと同一になるように設置すること。
- ③ 配管、配線、ピット穴及び基準点を避けて、実験ホール壁に取り付けること。

2.4. 共通ビーム

2.4.1. 概要

各真空機器を設置するためのビームである。本H型共通ビーム2本を共通ビーム支持架台2基の上に設置し、共通ビームには高い剛性と耐振動性が要求される。(図 2(d))

2.4.2. 仕様

- ① 支給するビーム素材の指定部を切削すること。
- ② 共通ビームの長さは、約 1880 mm : 2 本、約 1805 mm : 2 本、約 1970 mm : 4 本、とするが、受注後リングトンネル内において測量を行い確認すること。詳細は別途指示するため、承認図により確認すること。
- ③ 図 2-4(a)に記載の基準面の真直度を全数計測すること。また QST からの要求があった際にはその成績書を数値にて提出すること。
- ④ 据え付け前の基準面(切削面)には据え付け前の防錆措置として金ニスを塗布すること。据え付け時、機器設置の必要に応じ剥離しオイル塗布すること。基準面以外は塗装(マンセル 5R4/14)を行うこと。

2.4.3. 据付

共通ビームは、ビーム軸(水平方向:リングトンネル内床面に設置された2つの基準点を結ぶ軸;垂直方向:QSTが指定する4極電磁石の中心)に対して、 ± 0.2 mm以下の精度(計測機器の設置誤差等も含めて)で設置し、その成績書を数値にて提出すること。

3. フロントエンド冷却水配管部

3.1. 概要

ライン図(図 A)にある機器水冷却を必要とする機器へ冷却水を供給する。(図 3(a)~(d))構成部品は原則としてステンレスとする。作業前に全体の配管系統図を QST 担当者に提示し、承認を得た後に作業にとりかかること。

3.2. 主バルブ、取り合い点

- ① リングトンネルの天井から外側遮蔽壁面に沿って施設側冷却水配管が設置されており、床上高さ約 2 m 地点に取合バルブ(40A, JIS10K FF)が存在する。これより先を本仕様の範囲とする。

- ② 取合バルブの直後、IN と OUT の両方に 40A ストレーナ（100 メッシュ）を取り付けること。またストレーナは直管と交換できるように配管すること。
- ③ フロントエンドに沿った平行配管は 32A、取り合い点と平行配管の間は 40A で配管すること。
- ④ 取合バルブに付いている既設のバイパス配管は水抜き後に撤去すること。さらに撤去後、既設取合バルブのシート面リークの確認を行うこと。
- ⑤ ストレーナの外蓋を加工して、手動水・エア抜き用配管バルブを設けること（図 3-1-(d)）。

3.3. フロントエンド水冷母配管敷設

- ① 水流による振動が FE 機器に伝わらないように共通ビーム及び架台と独立に母配管支持柱を設けたうえ、共通ビームに沿わせて 32A の平行に母配管 (IN, OUT) を敷設すること。ただし、各系統の取り合い点から母配管の合流部は 40A とすること。また、合流部は鉛コリメータの近くに位置すること。なお、メンテナンスを容易にするため結合部周辺に工具が入る空間を確保すること。詳細は打ち合わせのうえ決定する。
- ② 各機器への枝配管用として適切なサイズのボールバルブ及びニードルバルブを必要個数、適切な位置に取り付けるとともに、どの機器用のバルブかを示すラベルも取り付けすること。ただし、保守用枝管部はボールバルブのみとする。
- ③ 母配管同士の接続にはユニオン継手もしくは大阪サニタリフェルール継手相当品を用いること。継手間のズレを吸収するために、200 mm 程度の金属フレキシホースを継手毎に挟むこと。詳細は打ち合わせのうえ決定する。
- ④ 最高使用圧力は 1MPa とすること。
- ⑤ 各母管 (IN, OUT) の合流部より上流に圧力計（現場表示のみ）を設けること。
- ⑥ 各母管 (IN, OUT) に水抜き用バルブを設けること。
- ⑦ 各母管 (IN, OUT) 終端付近にバイパス用バルブを設け、金属フレキシブルホースで接続すること。
- ⑧ 保守用、水抜き用バルブには封止栓を取り付けておくこと。
- ⑨ 母管 (IN, OUT) の最上流端及び最下流端に手動エア抜き用配管（図 3-1-(c)）を設けること。配管径は $\phi 4$ mm 以下とし、ニードルバルブを設けること。
- ⑩ 流量計の警報接点は無電圧接点とすること。信号は中継端子台を介してインターロックへ取り込むこと。流量計とはテフロンコネクタ取り合いとすること。
- ⑪ 流量計は東京計装製 FA4000 シリーズ相当品（禁油処理）とすること。
- ⑫ XY スリットには、L 型スリット u 型、d 型に別々に流量計を設置すること。なお、警報接点は u 型、d 型をシリーズに接続してインターロックへ取り込むこと。
- ⑬ 実験ホールに設置される IOM への配管をシールド壁底のピットを通して行うこと。ピット中はステンレス製フレキ配管とし、その他は全てステンレス固定配管とすること。継手は金属製食い込み継手 (Swagelok) を使用し、ピット内や増し締めが行いにくい場所では継手を設けないこと。架台等を利用して配管の固定を行うこと。

3.4. 各機器の通水・必要流量

- ① 母配管及び各機器への枝配管終了後、窒素ガスとスヌープを用いた耐圧 (1.0 MPa) 漏洩 (0.8 MPa) 試験を行うこと。
- ② 耐圧漏洩試験に合格後、十分なフラッシングを行った後、各系内のフラッシングを行うこと。さらに、2 日間程度の連続通水を行った後、ストレーナのメッシュ (100 メッシュ) を汚染が激しいときは新品に交換すること。なお、連続通水後の循環水の電気伝導率が施設循環水相当の電気伝導率 ($1\mu\text{S}/\text{cm}$ 以下) であることを確認すること。詳細は別途協議する。
- ③ 下表に示す水流があることを確認すること。この値に達し得ない場合は原因を追及し、配管の改造等で対処すること。

表：機器水量

機器名称	必要流量 (L/min)	バルブサイズ、配管径 (参考値)
フォトンダクトアブソーバ	10	1/2”、 $\phi 10$
前置マスク	10	1/2”、 $\phi 10$
光軸調整用フィルタ	10	1/2”、 $\phi 10$
可動マスク HX 型	20	3/4”、 $\phi 16$
アブソーバ HX型	20	3/4”、 $\phi 16$
XY スリット HX型	20 (各10)	3/4”、 $\phi 12\times 2$ 台
IOM	5	1/2”、 $\phi 10$

3.5. 冷却水配管仕様

フロントエンドの各冷却水配管は以下の仕様を満足しなければならない。

- ① 配管類の接続は枝管を含め金属製食い込み継手 (Swagelok) を用いること。他の接続方法を採用する際には QST 担当者の承認を得ること。
- ② リングトンネル内は金属配管 (基本的に SUS304) とすること。
- ③ 最高使用圧力は 1MPa とすること。
- ④ 各機器への枝配管において、原則として 16 mm 以下はミリ基準の配管を、3/4 以上はインチ基準の配管を使用すること。
- ⑤ 個別機器用の接点付き水流量計 (現場表示機能も必要) は、東京計装製 FA-4000 シリーズ (材質構成は耐放射線仕様、下限警報でロジックがノーマルクローズのもの) 相当品であること。禁油処理を施すこと。
- ⑥ 接点付き水流量計の警報接点は無電圧接点とすること。信号は中継端子盤を介してインターロックへ取り込む。流量計とはテフロンコネクタ (MOLEX 相当品) 取り合いとすること。
- ⑦ 金属フレキシホースを使用の際は、機器の駆動方向に留意し、継手に負荷のかからないようにすること。

- ⑧ フロントエンドの冷却水循環系は純水（電気伝導率 $1 \mu\text{S}/\text{cm}$ 以下）を使用しているため、配管内の清浄度管理を徹底させること。例えば、ノンオイル加工で切断する、溶接を行う際にはバックシールで配管内の酸化を防止する、酸洗した場合には酸が残らないように純水等で十分に洗浄し窒素ガスブローをする等を実施すること。

4. フロントエンド圧空配管部

4.1. 概要

ライン図(図 A)にある圧空駆動する機器へ圧搾空気を供給するための配管を敷設する。作業前に全体の配管系統図を QST 担当者に提示し、承認を得た後に作業にとりかかること。（図 4(a)）

4.2. 主バルブ、取り合い点

リングトンネルの天井から外側遮蔽壁面に沿って施設側圧空配管が設置されており、床上高さ約 2 m 地点に取合バルブ（15A）が存在する。これより先を本仕様の範囲とする。バルブの直下流にティを入れ、リング真空系とフロントエンド系に分岐するバルブ（15A）を設置する。分岐バルブから母配管まではステンレス配管とすること。基本的に全て金属配管（シンフレックスチューブは不可）とすること。

4.3. レギュレータ

- ① 施設側から供給される 0.7 MPa の圧力を 0.5 MPa に減圧すること。
- ② フィルタ付きのレギュレータを用いること。
- ③ 圧空供給側に逆流防止弁を設けること。

4.4. 圧空母配管

- ① フロントエンド共通レールに沿わせて $\phi 15 \text{ mm}$ の金属配管（アルミ）を敷設すること。
- ② 圧空枝配管用取り合い点を、保守用も含めた必要個数、適切な位置に設けること。取合部はクイックカプラ取り合い（日東工器；BSBM-2P 相当品）とすること。
- ③ 接点付き圧力計を設けること。
- ④ 実験ホール側に配管への配管は本母管よりシールド壁底のピットを通して行い、ミニヘッダーを設けること（保守用含む）。IOM 及び GV4 への枝配管はミニヘッダーから行うこと。

4.5. 圧空配管仕様

フロントエンドの各圧空配管は以下の仕様を満足すること。

- ① 配管類の接続は金属製食い込み継手（Swagelok）を用いること。（フェルールも含めて金属仕

様)

- ② リングトンネル内は全て金属配管とすること。
- ③ 最高使用圧力は 0.8 MPa とすること。

4.6. 試験

全ての圧空配管終了後に漏洩試験（圧力 0.5 MPa）を実施し、1 時間保持で減圧が 5%以下であることを確認すること。

5. フロントエンド制御盤部

5.1. 機器仕様

- ① 基本的に高さ 2.1 m の鍵付き扉付き EIA 規格（42U）に準拠した 19 インチラック 1 台以上を準備し（以下「FE 主制御ラック」という。）、支給品（FEPLC 制御盤及び EtherCAT マスターカード搭載ラックマウントサーバ）を含む制御盤部構成機器（表：ラック組込機器）を組み込むこと（図 5(a)）。詳細は別途協議のうえ決定すること。
- ② フロントエンドの制御に必要な全てのケーブルを準備すること。
- ③ 上位の加速器インターロックシステム、安全インターロックシステム等と取り合うために必要な全ての盤内配線を実施するとともに、取合コネクタ（別途指示）も準備すること。

5.2. 真空ポンプ制御装置

下記の各装置を FE 主制御ラックに収納すること。

- | | |
|--|-------|
| ① ノーブルポンプ制御装置（キヤノンアネルバ製 P-521NP 相当品） | : 3 台 |
| ② ノーブルポンプ制御装置（キヤノンアネルバ製 P-511NP 相当品） | : 1 台 |
| ③ サブリメーション制御装置（キヤノンアネルバ製 SR-TVP-050 相当品） | : 1 台 |
| ④ タイバックポンプ切替器制御装置 | : 1 台 |
- ・ タイバックポンプ切替器本体はリングトンネル内に設置すること。
 - ・ タイバックポンプは内周通路に設置されるタイバック切替器制御装置によってフラッシング対象となるタイバックポンプが選択（最大 4 台）できること。
 - ・ サブリメーション制御装置によって当該タイバックポンプに電源を供給できる配線を敷設すること。

5.3. 真空計制御装置

下記の装置を FE 主制御ラックに収納すること。

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 電離真空計制御装置（キヤノンアネルバ製 M-923DD 相当品） | : 4 台 |
|----------------------------------|-------|

5.4. 高速シャッター制御装置

下記の装置をFE主制御ラックに収納すること。

緊急遮断シャッターシステム (VAT製 770VF-16NN-AHN2 相当品) : 1台

ただし、以下の機器から構成されていること。

- | | |
|---------------------------|------|
| 1) 基本デバイス (VAT製 VF-2 相当品) | : 1個 |
| 2) コントロールモジュール (VAT製) | : 1個 |
| 3) HV センサーモジュール (VAT製) | : 2個 |
| 4) バルブモジュール (VAT製) | : 1個 |

5.5. ステッピングモータ駆動制御関連装置

下記の各装置をFE主制御ラックに収納すること。

- | | |
|---|------|
| ① ステッピングモータ制御装置 (ツジ電子製 PM16C-16EC2 相当品) | : 1台 |
| ② ステッピングモータドライバ (メレック製 H-584/AD-5610 1軸ユニット相当品) | : 6台 |
| ③ エンコーダ表示器 (ツジ電子製 ER4C-04A 相当品; 4ch表示) | : 2台 |
| ④ XYスリット開口制限ユニット (ツジ電子製 T3956-02 相当品) | : 1台 |

XYスリット開口制限ユニットによりXYスリットの開口が規定値(可変であること)以上に広がらないようにすること。

5.6. 瞬時電圧低下保護装置

下記の装置をFE主制御ラックに収納すること。

瞬時電圧低下保護装置 指月電機製作所 YS10BC12C1RA(相当品) : 1台

5.7. FE/PLC 制御盤

支給するFE/PLC制御盤1台をFE主制御ラックに収納すること。

- ① FE/PLC制御盤は現場モードでFE機器の制御を行うとともに、上位のインターロックシステムとの取り合いとなる。
- ② FE/PLC制御盤への信号入力コネクタ付きケーブルを製作し接続すること。
- ③ 必要により現地納入前に工場内で取り合い確認試験を行うこと。なお、試験に必要な機器/接点信号は受注者側で準備すること。試験には支給するFE/PLC制御盤を使うこと。詳細は別途協議のうえ決定すること。
- ④ FE/PLC操作盤による圧空駆動のためのDC24Vを準備すること。

5.8. ラックマウントサーバ

支給するラックマウントサーバ 1 台を FE 主制御ラックに収納すること。本機器は FE/PLC 制御盤を介しフロントエンド機器を監視する。上位のネットワークシステムとの取り合いとなる。

5.9. スイッチングハブ

下記のスイッチングハブを FE 主制御ラックに収納すること。

レイヤー2 Giga 対応 PoE Web スマートスイッチ (ELECOM EHB-SG2C16-PL 相当品) : 1 台

表：ラック組込機器

	機器	相当品/仕様	
真空ポンプ 制御装置	ノーブルポンプ制御 装置	キヤノンアネルバ製 P-521NP	3 台
	ノーブルポンプ制御 装置	キヤノンアネルバ製 P-511NP	1 台
	サブリメーション制 御装置	キヤノンアネルバ製 SR-TVP-050	1 台
	タイバックポンプ切 替器制御装置	<ul style="list-style-type: none"> ・切替器本体は蓄積リングトンネル内に設置すること。 ・内周通路に設置されるタイバックポンプ切替器制御装置によってフラッシング対象となるタイバックポンプが選択（最大 4 台）でできること。 ・サブリメーション制御装置によって当該タイバックポンプに電源を供給できる配線を敷設すること。 	1 台
真空計制御 装置	電離真空計制御装置	キヤノンアネルバ製 M-923DD	4 台
高速シャッ ター制御装 置	緊急遮断シャッター システム	VAT 製 770VF-16NN-AHN2 以下の機器から構成されていること。 1) 基本デバイス (VAT 製 VF-) : 1 個 2) コントロールモジュール (VAT 製) : 1 個 3) HV センサーモジュール (VAT 製) : 2 個 4) バルブモジュール (VAT 製) : 1 個	1 台
ステッピング モータ駆 動制御関連 装置	ステッピングモータ 制御装置	ツジ電子製 PM16C-16EC2	1 台
	ステッピングモータ ドライバ	メレック製 H-584/AD-5610 1 軸ユニット	6 台

	エンコーダ表示器	ツジ電子製 ER4C-04A ; 4ch 表示	2 台
	XY スリット開口制限 ユニット	ツジ電子製 T3956-02 (XYスリットの開口が規定値 (可変であること) 以上 に広がらないようにすること。)	1 台
瞬時電圧低 下保護装置	瞬時電圧低下保護装 置	指月電機製作所 YS10BC12C1RA	1 台
FE/PLC 制 御盤	FE/PLC 制御盤	支給品	1 台
ラックマウ ントサーバ	EtherCAT マスターボ ード搭載ラックマウ ントサーバ	支給品	1 台
スイッチン グハブ	レイヤー2 Giga 対応 PoE Web スマートス イッチ	ELECOM EHB-SG2B16F-PL	1 台

5.10. 据付・通線仕様

制御盤部据付・通線仕様は、FE 主制御ラックの設置と、蓄積リングトンネル内の機器と内周通路のラック間の配線（ケーブルも含む）、ラック内の盤内配線により構成される。蓄積リングトンネルから内周通路及び実験ホールへの配線はピットを通して行う。（図 5(b)）必要に応じてピット蓋（縞鋼板もしくはグレーチング）に切り欠きを加工すること。詳細は QST 担当者と相談すること。各ケーブルは必要に応じて現物で長さを合わせ、端末処理を施すこと。また、基本的に全ての配線の両端部には識別可能なタグを取り付けること。

- ① FE 主制御ラックは内周通路の指定場所にアンカーで固定すること。
- ② リングトンネル内の配線は放射線環境下であることを考慮し、基本的に、架橋ポリエチレンを絶縁体とする難燃エコケーブル（IEEE 準拠）を用いること。LAN ケーブルは、エコケーブル（EM ケーブル）あるいは、電気用品安全法の耐燃性 JISC3005 傾斜試験に適合したケーブル（規格：Cat6、UTP、両端 RJ45 端子）であること。
- ③ リングトンネル内の各機器と内周通路側制御盤部間のケーブルはリングトンネル床下に設けられた 3 本のピット穴（ $\phi 100$ mm）を通して配線すること。図 5(b)に記載の制御盤部からリングトンネル内ピットまでの直線距離を参考とし、受注後に測量を行い、余長を含めた各ケーブルの最適長さを決定すること。低容量のケーブルは多芯ケーブルにまとめ、リングトンネルと内周通路（FE 主制御ラックを想定）に中継端子盤を設けて、配線の断面積を極力小さくするように心がけること。なお、敷設ケーブルの内、QST が指定するものについては、実装長さをリストにして提出すること。
- ④ 主制御ラック用電源は、内周通路を挟んだ反対側壁に設置されている分電盤内に、1 本のフ

ロントエンド用として、

- ・ 3φ 210 V/30 A (粗排気ポンプユニット用)
- ・ 1φ 3W210 V/20 A (FE 主制御ラック用)
- ・ 1φ 10 5V/30 A (FE 主制御ラック用)
- ・ 1φ 105 V/15 A (保守作業用)

の各ブレーカが準備されている(図 5(c))。この分電盤が取り合い点である。内周側の縦方向のケーブルラダーは全周に 8 箇所設けられている。ただし、FE 主制御ラックへの立ち下げ用ラダー等の施設側で準備されていないケーブルラダーは全て準備すること。

- ⑤ 3φ 210 V/30 A (粗排気ポンプユニット用) と 1φ 105 V/15 A (保守作業用) は、直接リングトンネル内に配線を行い、リングトンネル内にもブレーカ (各 1 個) を設置すること。さらに、100 V 系にはテーブルタップを、200 V 系には粗排気ポンプユニットに接続可能なコネクタを接続しておくこと。また、FE/PLC 制御盤及びラックマウントサーバ(共に支給品)とブレーカの間には瞬低保護装置を配置すること。
- ⑥ 共通ビーム支持架台の通線ルートには、金属製カッティングダクトを設置し、配線はこの中に納めること。配線の詳細は別途協議のうえ決定すること。
- ⑦ 全ての接点付水流量計及び圧空用接点付圧力計の信号ケーブルは、各流量計、圧力計の近傍で、テフロンコネクタ (MOLEX) 取り合いとすること。
- ⑧ 高熱負荷機器 (可動マスク、アブソーバ、XY スリット) 本体に取り付けられる熱電対は、機器本体近くの熱電対専用コネクタと、リングトンネル側中継端子盤の 2 ヶ所で中継し、内周通路側で監視できるようにすること。また、各配線の端末には識別可能なタグを取り付けること。
- ⑨ FE/PLC 制御盤に必要な各種真空機器のステータス信号や接点信号を取り出し、端子台/コネクタ取り合いとすること。取り合いについては別途協議のうえ決定すること。FE/PLC 制御盤及びラックマウントサーバと上位ネットワークへの取り合いは RJ45 取り合いとする。パッチパネル、パッチケーブルを用い接続すること。
- ⑩ 高速シャッター、電離真空計、イオンポンプ等の制御装置の出力からも、FE/PLC 制御盤加速器に必要な信号を取り出すこと。必要に応じて拡張端子台を設けること。取り合いについては別途協議のうえ決定すること。
- ⑪ ステッピングモータのケーブル・コネクタの形式及びピンアサインについては別途協議のうえ決定すること。
- ⑫ ステッピングモータ制御関連機器については、モーター部、ドライバ、コントローラ間の全ての配線を行い (図 5(d))、ドライバのディップスイッチの設定も行うこと。なお、XY スリットの精密駆動ステージに関して、コントローラから CW 方向に送った際の移動方向が下記のようなになる (必要に応じて反転ケーブル反転コネクタを使用する) こと。
X 軸 : 放射光を背に受けた状態で右側 (実験ホール側) が CW
Y 軸 : 鉛直上方が CW
- ⑬ 図 5(d) に従って、開口制限ユニット、エンコーダカウンタ、ステッピングモータ制御装置間の配線を行い、動作確認試験を行うこと。

- ⑭ FE 制御ラックから加速器インターロックラックまではU/UTP インナーシースケーブル(規格: Cat6、24 芯ケーブル)を持ること。
- ⑮ FE 主制御ラックから蓄積トンネルに通線し FE 共通架台付近に AC200V 及び 100V 用コンセントを設けること。詳細は別途協議する。

6. 光取出管端部

本装置と加速器との取り合い箇所となる手動式オールメタルゲートバルブの下流側には水冷配管が施された銅ブロックが設置されている。本装置を加速器真空機器に接続する際は、この銅ブロックと水冷配管の取り外し、新しい水冷配管を製作し加速器冷却水還りヘッダーの指定する場所に接続すること(図 6(a))。水冷配管作業に係る加速器冷却水の停止、通水、フラッシング作業は第 3 章に準ずる。詳細は別途協議する。

表 A: ライン表 HX (参考値)

機器名	開口、 H×V(mm)	長さ (mm)	備考
真空ベローズ (TYPE1)	φ 42.7 / φ 63.5	150	ICF70/ICF114
フotonダクトアブソーバ		220	
前置マスク HX 型	IN 50×40、OUT 18×18	130	
真空ベローズ (TYPE2)	φ 38	130	ICF70/ ICF70
変換フランジ(70/152)		20	ICF70/ICF152
端部排気真空槽 (EVPC)		300	ICF152/ICF152、IG1
真空ニップル		76	ICF152/ICF114 変換ニップル
オールメタルバルブ (ICF70)	φ 35	72	支持台付き、GV1
真空ニップル	φ 35	459	ICF70、パイプ支持台付き
真空ベローズ (TYPE2)	φ 38	130	ICF70/ICF70
高速シャッター	φ 35	60	ICF70、支持台付き
排気真空槽 1 (VPC1)		250	IG2、ICF70/ICF70、FCS センサー付き
真空ベローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
光軸調整用フィルター	V24	200	スクリーンモニタ (SCM1) 含む、 ICF70/ICF70
アブソーバ HX 型	7×7	1260	ベローズ+本体+ベローズ、 上流ベローズは支持付
鉛コリメータ	φ 23	340	独立支持架台
真空ベローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
オールメタルバルブ	φ 35	72	バネ支持台付き、GV2
排気真空槽 2 (VPC2)	φ 35	250	IG3、ICF70/ICF70
真空ベローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
可動マスク	φ 4	900	ベローズ+本体*ベローズ
XYスリット HX 型		1860	
真空ベローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
オールメタルバルブ (ICF70)	φ 35	72	バネ支持台付き、GV3
排気真空槽 2 (VPC3)	φ 35	250	IG4、FCS センサー付き
真空ベローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
スクリーンモニタ (SCM2)	φ 35	140	
真空ベローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
ビームシャッター (BS)		400	
BS 下流ベローズ	φ 35	280	
シールド壁貫通管	30×20	1300	

真空ペローズ (TYPE2)	φ 35	130	ICF70/ICF70
光電子モニター		200	
オールメタルバルブ (ICF70)	φ 35	72	バネ支持台付き、GV4、ブランクフランジ付き

知的財産権特約条項

(知的財産権等の定義)

第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

- 一 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利（以下総称して「産業財産権等」という。）
 - 二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
 - 三 著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。）及び外国における著作権に相当する権利（以下総称して「著作権」という。）
 - 四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利
- 2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
- 一 特許権の対象となるものについてはその発明
 - 二 実用新案権の対象となるものについてはその考案
 - 三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出
- 3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)

第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

- 一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。
 - 二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
 - 三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
 - 四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権（仮専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾（以下「専用実施権等の設定等」という。）をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。
 - イ 子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
 - ロ 承認TLO（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成10年法律第52号）第4条第1項の承認を受けた者（同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。））又は認定TLO（同法第11条第1項の認定を受けた者）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
 - ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合
- 2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。
 - 3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

（知的財産権の報告）

第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。

- 2 乙は、産業技術力強化法（平成12年法律第44号）第17条第1項に規定する特定研

究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）、実用新案法施行規則（昭和35年通商産業省令第11号）及び意匠法施行規則（昭和35年通商産業省令第12号）等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない。

- 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内（ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき（ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。）は、実施等した日から60日以内（ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転）

第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合（本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。）には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

- 2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。
- 3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場合に限る。）である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。
- 4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内（ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾）

第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

- 2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。
- 3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場合に限る。）である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。
- 4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内（ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄）

第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属）

第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。

一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。

- 2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
- 3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)

第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)

第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)

第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。

2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的实施をするときは、甲が自ら商業的实施をしないことに鑑み、乙の商業的实施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)

第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(著作権の帰属)

第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。

2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。

3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。

(合併等又は買収の場合の報告等)

第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社に変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し

なければならない。

2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。

3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。

一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。

二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。

三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。

(秘密の保持)

第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。

(委任・下請負)

第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(協議)

第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

(有効期間)

第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

以上